(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-100283

(43)公開日 平成9年(1997)4月15日

(51) Int.Cl. ⁶	識別記号	庁内整理番号	FI		技術表示箇所
C 0 7 D 519/06			C 0 7 D 519/00	385	
A 6 1 K 31/545	ADZ		A 6 1 K 31/545	ADZ	
C 0 7 D 501/36	114	9164-4C	C 0 7 D 501/36	114	

(21) 出願番号 特顧平8-189327 (71) 出願人 000002934 武田薬品工業株式会社 大阪府大阪市中央区道修町四丁目 (31) 優先権主張番号 特額平7-182367 (72) 発明者 (32) 優先日 平 7 (1995) 7 月19日 (72) 発明者 小此木 研二	
(22) 出願日 平成8年(1996) 7月18日 大阪府大阪市中央区道修町四丁目 (72) 発明者 多和田 紘之 (31) 優先権主張番号 特願平7-182367 大阪府高槻市宮之川原1丁目11番 (32) 優先日 平7(1995) 7月19日 (72) 発明者 小此木 研二	
(72) 発明者 多和田 紘之 大阪府高槻市宮之川原 1 丁目11番 (32) 優先日 平 7 (1995) 7 月19日 (72) 発明者 小此木 研二	
(31)優先権主張番号 特願平7-182367 大阪府高機市宮之川原1丁目11番 (32)優先日 平7(1995)7月19日 (72)発明者 小此木 研二	日1番1号
(32) 優先日 平 7 (1995) 7 月19日 (72) 発明者 小此木 研二	
	番1号
(33)優先権主張国 日本(JP) 大阪府三島郡島本町若山台1丁目	目 5 番20-
(31) 優先権主張番号 特願平7-193686 101号	
(32)優先日 平7(1995)7月28日 (74)代理人 弁理士 朝日奈 忠夫 (外1名	名)
(33) 優先権主張国 日本 (JP)	

(54) 【発明の名称】 セフェム化合物、その製造法および抗菌組成物

(57) [联約]

【課題】 MRSAを含むグラム場性菌、グラム陰性菌に 対して優れた抗菌活性を示す抗菌剤の提供。

【解決手段】式

[化1]

 上が医寒組成物。

「鉢 新 糖 東 の 新 Ⅲ 1 (請求項1)式

〔式中、 R ¹は保護されていてもよいアミノ基を示じ、 R²は水素原子または炭素原子を介して結合する基を示 し、R³およびR⁴は一方が置接されていてもよいピリジ ニウム基を、他方が水素原子または貿換されていてもよ い炭化水素基を示すか、あるいはR³およびR⁴は互いに

結合して4級化した窒素原子を含む證拠されていてもよ い複素環を示し、QおよびXはそれぞれ窒素原子または※

※ C H を示し、 Y は S 、 O または C H 2を示し、 n は 0 ま 10 たは1を示す。ただし、nが0の時、YはSまたはOを 示す。〕で扱される化合物またはそのエステルあるいは

【請求項2】式 14:21

$$\begin{array}{c} R^1 + S \\ O \\ O \\ O \\ O \\ O \end{array} = \begin{array}{c} CONH \\ O \\ O \\ O \\ O \end{array} = \begin{array}{c} CCH \\ O \\ O \\ O \\ O \end{array} = \begin{array}{c} X \\ O \\ O \\ O \\ O \\ O \end{array} = \begin{array}{c} R^8 \\ O \\ O \\ O \\ O \\ O \\ O \end{array}$$

〔式中の各記号は請求項1と同意歳を示す。〕 で表され る化合物またはそのエステルあるいはその塩。

〔請求項3〕 R²が征換されていてもよい C₁₋₆アルキル 基またはC3-5シクロアルキル基である請求項1 記載の 化合物。

基で、R⁴が水素原子である翻求項1記載の化合物。 【請求所5】 [(t. 3)

〔式中、R⁵は置換されていてもよい炭化水製基を示 す。〕で示される据である翻求項1記載の化合物。

[請求項 6] Q が窒素原子である請求項 1 記載の化合

【結求項7】 X が縦器原子である請求項1 記載の化合

[請求項9]式

[式中の記号は請求項」記載と同意義を示す。] で表さ 50 れる化合物またはそのエステルあるいはその塩と式

[化5]

$$\begin{array}{c}
R^{1} \downarrow S \\
\downarrow OR^{2}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
CONH \\
COO \\
COO \\
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
CCH = CH)_{\overline{n}} S \downarrow S \\
R^{4'}
\end{array}$$

20

【式中、 R^3 、および R^4 、は一方が置換されていてもよいピリジル器を、他方が水瀬原子または置換されていてもよい炭化水素 語を示すか、あるいは R^3 、および R^4 、は五いに結合して監察原子を含む置換されている複葉原を示し、その他の紀号は請求項:と同窓鏡を示す。】で表され合物またはそのエステルあるいはそいてもよいピリジル器または R^4 、で示される置換されていた結合して形成される整類原子を含む歴換されていてもよいピリジル器または R^5 、および R^4 、が五いに結合して形成される整類原子を含む歴換されていてもよい複葉原中の監察原子を4級化させ、必要に応じて保護接触法することを特数とする耐速項1 配線の化合物の製造法

【請求項 1 1 】 請求項 1 記載の化合物を含有する医数組成物

【簡求項12】 抗菌組成物である簡求項11配数の医薬 組成物

【請求項13】抗MRSA剤である體求項11記載の医 30 薬組成物。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明が属する技術分野】 本発明は広範囲のグラム場性 図およびグラム酸性菌、特にブドウ球菌およびメチシリン 記性 ブドウ球菌 (MRSA) に僅れた抗菌作用を有す る新規なセフェム化合物、その製造法および抗菌組成物 に関する。

[0002]

[0003]

* (式中の記号は請求項1 記載と同意哉を示す。) で表されるカルボン酸またはその塩もしくは反応性誘導体とを 反応させ、必要に応じて候額基を除去することを特数と する額求項1 記載の化合物の製造法。

【請求項10]式

11661.

【発明が解決しようとする離題】従来のセフェム化合物は、抗菌活性の範囲または強さの点で、とりわけ従来のセファロスポリン化合物にブドウ球菌およびメチシリンのではブドウ球菌(MRSA)などに対する抗菌作用が十分に満足できるものではなく、特にMRSAは、近年血気な感染症を引き起こしており、この点を克服した新しい化合物の出現が望まれていた。

[0004] [課題を解決するための手段]本発明者らは、上記事情に概み、概定報々研究を重ねた結果、セフェム、オキサセフェムまたはカルパセフェム骨格の3位に式

$$-(CH = CH)_{\overline{n}}S \xrightarrow{X} R^3$$

(式中、R³およびR⁴は一方が超換されていてもよいピ リジニウム茲を、他力が水剝刷デまたは超換されていて もよい段化水剁瓶を示すか、あるいはR³およびR⁴は正 いに結合して4 糖化した質謝原子を含む超換されていて もよい報源域を示し、Xは窒素原子またはCHを示し、 nは0または1を示す。)で表される菇、かつ7位に式 [作8]

【式中、 R³ は保髄されていてもよいアミノ基を、 R² は 水製源子または以射原子を介して組合する基を、 Q は空 製原子または C 分をそれぞれ示す。 プロ することに 化学構造上の特数を有するセフェム、 オキサ セフェムまたは カルパセフェム化合物またはそのエステ ルあるいはその塩を初めて合成し、さらに合成された化 合物が 上記の特別な化学構造に ボづいて 予想外にもプレ 50 フ厚岡および M R S A を含む グラム陽性値 および グラ

* 【0 0 0 5】 すなわち、本発明は、 (1) 式 [l] 陰性菌などに対して幅広く優れた抗能作用を有すること 化91 を見出し、これらに基づいて本発明を完成した。

※いはその塩、(2)式[I'] (式中、YはS、OまたはCH2を、その他の配号は前 記と同意義を示す。ただし、nが0の時、YはSまたは 10 【化10】 〇を示す。〕で表される化合物表たはそのエステルある※

[式中の記号は前配と開業機を示す。] で表される化合 物またはそのエステルあるいはその塩。。(B) 式 [II]:★

$$\begin{array}{c}
NH_2 \\
0
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
(CH = CH)_{\overline{n}}S \\
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
R^4
\end{array}$$
(11)

★ 【化11】

〔式中の記号は前記と同意義を示す。〕 で表される化合 物またはそのエステルあるいはその塩と式 [IH]

ポン酸またはその塩もしくは反応性誘導体とを反応さ せ、必要に応じて保護基を除去することを特徴とする前 記 (1):記載の化合物の製造法、(4)式:[IV] 【化131

☆〔式中の記号は前記と同意義を示す。〕で表されるカル

$$\begin{array}{c|c} R^1 & \\ \hline \\ CONH & \\ \hline \\ CR^2 & \\ \hline \\ CR = CB >_{\overline{n}} S & \\ \hline \\ R^{\mu\nu} \end{array} \right) \qquad (1V)$$

いビリジル基を、他方が水素原子または置換されていて もよい炭化水素基を示すが、あるいはR*′およびR*′ は互いに軸合して穿素原子を含む置換されていてもよい 複素機を示し、その他の配号は前配と関係機を示す。〕 で表される化会物またはそのエステルあるいはその塩に おけるR' またはR' で示される関係されていてもよ いピリジル基本たはスパーおよびスペーが匠いに結合して 形成される意像原子を含料着機されていてもよい複素環 中の事業顕析を4歳化を歩、必要に述びて保護基を除去 することを検験と引み制配(1)・配義の化合物の製造 50 合物 (1) のエステルの塩) を含む。以下本願明報書に

(式中、R² / およびR⁴ / は一方が置換されていてもよ 40 法、および(5)前記(1)記載の化合物を含有する医 薬組成物などに関する。

【0006】本明細書におけるセフェム化合物は「ザ・ ジャーナル・オプ・ジ・アメリカン・ケミカル・ソサイ エティ」第84巻,3400頁(1962年)に記載され ている「セファム」に基づいて命名された化合物群であ り、セフェム化合物はセファム化合物のうち3、4 - 位 に二重結合を有する化合物を意味する。なお、本発明の 化合物は遊離形を表している式 [I] の化合物またはそ のエステルあるいはその塩(化合物 [1] の塩または化 おいては、特別の場合を除き、遊離形を表している式 (1) の化会論をたけそのエステルあるいはその鑑を単 に、化合物 [1]、技能化合物 [1] あるいは式 [1] で 表される化合物とのみ略称する。従って本語明製書の化 合物 [1] は適常、遊離形のみならずそのエステルおよ パそれらの地を含むものとする。このことは、化合物 (1) のみならず、化合物 (1')、源料化合物、たとえ は下記の化合物 (11) 、 (111) 、 (110) についても何 様である。

【0007】R上は保護されていてもよいアミノ基を表 わす。B-ラクタムおよびペプチドの分野ではアミノ基 の保護基は充分に研究されていてその保護法はすでに確 立されており、本発明においてもアミノ基の保護基とし てはそれら公知のものが確定に採用されうる。アミノ基 の保護基としてはたとえば、最後されていてもよいC ...アルカノイル薬、産機されていてもよいC。。アルケ ノイル基、置換慮れていてもよいCoinoアリールーカル ボニル基。複奏器カルボニル基。個線されていてもよい Ci-ioアルキルスルホニル製: 画義されていてもよいC 6-10アリールスルホニル基ト環境オキシカルボニル基. 最後されていてもよいカルバディル英、 景様されていて もよいチオカルバモイル熱、微熱されていてもよいC e-10 アリールーメチル基、機能されていてもよいジC s-10アリールーメチル基、繊維されていてもよいトリC 。10アリールーメチル基、推摘されていてもよいCelia アリールーメチレン基、動機されていてもよい Ce-10ア リールチオ基、面換シリル基、2-C1-10アルコキシー カルポニル-1-メチル-1-エテニル基, 式M'OC O- (式中、Miはアルカリ金属を示す。) で表される 其などが用いられる。

【0008】「置換されていてもよいC1-4アルカノイ ル基」としてはたとえば、ハロゲン、オキソ、C1-4ア ルコキシ、Citaアルカノイル、Co-10アリール、C 6-10 アリールオキシ、Co-10 アリールチオなどから選ば れた1~3個の量機勘で電機されていてもよいC...ア ルカノイル基が用いられ、具体的にはたとえば、ホルミ ル、アセチル、プロピオニル、プチリル、パレリル、ピ パロイル、サクシニル、グルタリル、モノクロロアセチ ル、ジクロロアセチル、トリクロロアセチル、モノブロ モアセチル、モノフルオロアセチル、ジフルオロアセチ ル、トリフルオロアセチル、モノヨードアセチル、アセ トアセチル、3-オキソプチリル、4-クロロ-3-オ キソプチリル フェニルアセチル ロークロロフェニル アセチル、フェノキシアセチル、ロークロロフェノキシ アセチルなどが用いられる。『歐鏡されていてもよいC a.sアルケノイル基:としてはたとえば、ハロゲン,C a-10 アリールなどから選ばれた1~3個の置換基で置換 されていてもよいCz・アルケノイル基が用いられ、具 体的にはたとえば、アクリロイル、クロトノイル、マレ オイル、シンナモイル、p-クロロシンナモイル、β-50 れていてもよいC1-10アルキルスルホニル基が用いら

フェニルシンナモイルなどが用いられる。「曹雄されて いてもよいCa-10アリールーカルポニル基」としてはた とえば、ハロゲン、ニトロ、ヒドロキシ、C1-6アルキ ル、C1-4アルコキシなどから選ばれた1~3個の着棒 基で蓄格されていてもよいC+++0アリールーカルポニル 基が用いられ、具体的にはたとえば、ペンゾイル、ナフ トイル、フタロイル、p-トルオイル、p-tert-プチ ルベンゾイル、ローヒドロキシベンゾイル、ローメトキ シペンソイル、p-tert-プトキシペンソイル、p-ク ロロベンゾイル、p-ニトロベンゾイルなどが用いられ

【0009】「複素理カルボニル茶」における「複素理

ρ

基」は複素環の炭素原子に結合している水素原子を1個 とりのぞいてできる基をいい、そのような複象要はたと えば、窒素原子(オキシド化されていてもよい)、 野宝 原子、硫黄原子などのヘテロ原子を1~数個、好ましく は1~4個含む5~8員環またはその総合環をいう。こ のような複素環基としては具体的には2-または3-ビ ロリル: 3-、4-または5-ピラゾリル: 2-、4-20 または5-イミダゾリル;1,2,3-または1,2,4-トリアゾリル: 1日-または2日-テトラゾリル: 2-または3-フリル:2-または3-チエニル:2-.4 または5-オキサゾリル:3-、4-または5-イソ キサゾリル:1、2、3ーオキサジアゾールー4ーイルま たは1,2,3-オキサジアゾール+5-イル:1,2,4 - オキサジアゾール-3-イルまたは1,2,4-オキサ ジアゾールー5-イル: 1,2,5-末たは1,3,4-オ キサジアゾリル: 2-. 4-または5-チアゾリル:3 4 - または5 - イソチアゾリル: 1, 2, 3 - チアジ 30 アゾールー4-イルまたは1,2,8-チアジアゾールー 5-イル: 1, 2, 4-チアジアゾール-3-イルまたは 1.2.4-チアジアゾール-6-イル:1.2.5-また は1,3,4-チアジアゾリル:2-または3-ピロリジ ニル: 2-、3-または4-ピリジル: 2-、3-また は4-ピリジル・N・オキシド:3-または4-ピリダ ジニル:3-または4-ピリダジニル-N-オキシド: 2-, 4-または5-ビリミジニル:2-, 4-または 5-ピリミジニル-N-オキシド: ピラジニル:2-. 3-または4-ピペリジニル:ピペラジニル:3H-イ ンドールー2-イルまたは3H-インドールー3-イ ル;2-,3-または4-ピラニル;2-,3-または 4-チオピラニル:ベンゾピラニル:キノリル:ピリド (2,3-d) ピリミジル: 1,5-, 1,6-, 1,7 -, 1,8-, 2,6-または2,7-ナフチリジル;チ エノ (2,3-d) ピリジル: ピリミドピリジル: ピラ ジノキノリル:ペンゾピラニルなどが用いられる。「置 換されていてもよい C1-10 アルキルスルホニル基1 とし てはたとえば、ハロゲン、C4-10アリール、C6-10アリ ールオキシなどから遊ばれた1~B個の産換基で産換さ

れ、具体的にはたとえばメタンスルホニル、エタンスル ホニル、カンファースルホニルなどが用いられる。

「番棒オキシカルボエル幕」としてはたとえば、C1-10 アルコキシーカルボニル基。 Ca-raシクロデルキルオキ シーカルボエル基、Cino製機器式機化水素オキシーカ ルポニル基。Cara アルケニルオキシーカルポニル基。 Co-10 アリールオキシーカルポニル基本をはC1-10 アラ ルキルオキシンカルボエル熱のほか、それらがさらにC 1-8アルコギシ、C1-8 アルカソイル、Cibro アルカノイ ルオキシ、C1-10アルコキシーカルポニルオキシ、C 3-10シクロアルキルオポシーカルポニルオキシ、置換シ リル基(後記する屋銭シリル基、例、トリメチルシリ ル、tertープチルシメチルシリル等)、Ci-aアルキル スルホニル: ハロゲン, シアソ、Ci-sアルキル、ニト 口等から強はれる置数器を1~3個有しているものも含 まれる。具体的には例えばメトキシメチルオキシカルボ ニル、アセチルメチルオキシカルポニル、2-トリメチ ルシリルエトキシカルポニル、2-メタンスルホニルエ トキシカルポエル、2、2、2-トリクロロエトキシカル ポニル、2-シアノエトキシカルボニル、アリルオキシ カルポニル、p-メチルフエノキシカルポニル、p-メ 30 トキシフエノキシカルポニル、p-クロロフエノキシカ ルポニル、mーニトロフエノキシカルポニル、D-メチ ルベンジルオキシカルポニル、p-メトキシベンジルオ キシカルボニル, ロークロロペンジルオキシカルボニ ル、p-ニトロペンジルオキシカルポニル。o-ニトロ ペンジルオキシカルボニル、3、4-ジメトキシー6-ニトロベンジルオキシカルポニルなどが用いられる。

【0011】 『屋装されていてもよいカルバモイルあ」としてはたとえば、Crasアルキル、Csisアリール、Csisアルカノイル、Csisアリールカルボニル、Cisアルカノイル、Csisアリーカルがエル、Cisアルカナンーフェニル基などから選ばれた1または2個の置接基で置接されていてもよいカルバモイル基が用いられ、具体的にはたとえば、N-メテルカルバモイル、N-ツジェデルカルバモイル、N-ツェデルカルバモイル、N-アセデルカルバモイル、N-アセデルカルバモイル、N-アセデルカルバモイル、N-アセデルカルバモイル、N-アセデルカルバモイル、N-アセデルカルバモイル、N-アセデルカルバモイル、N-アセデルカルバモイル、N-アセデルカルバモイル、N-アセデルカルバモイル、N-アセデルカルバモイル、N-アセデルカルバモイル、N-アセデルカルバモイル、N-アセデルカルバモイル、N-ア・ビアルカルバモイル、N-バーベーターメトキシフェエル)カルバモイルが必然用いられる。

「置換されで約」で考よいチオカルパモイル基」としては ルシリル、 $tert-プチルジメチルシリル、<math>-SI(CH_1)$ たとえば、 C_{1-1} アルキル、 C_{4-1} アリールなどから速 50 $_{2}$ $_{3}$ $_{4}$ $_{5}$ $_{4}$ $_{5}$ $_{6}$ $_{6}$ $_{7}$ $_{7}$ $_{7}$ $_{7}$ $_{7}$ $_{7}$ $_{7}$ $_{8}$ $_{8}$ $_{1}$ $_{1}$ $_{1}$ $_{1}$ $_{1}$ $_{1}$ $_{1}$ $_{1}$ $_{2}$ $_{1}$ $_{1}$ $_{2}$ $_{3}$ $_{1}$ $_{1}$ $_{1}$ $_{2}$ $_{3}$ $_{4}$ $_{1}$ $_{1}$ $_{1}$ $_{2}$ $_{3}$ $_{4}$ $_{1}$ $_{1}$ $_{1}$ $_{2}$ $_{3}$ $_{4}$ $_{1}$ $_{2}$ $_{3}$ $_{4}$ $_{1}$ $_{3}$ $_{4}$

10 ばれた1または2個の関集系で開発されていてもよいチ オカルバモイル基が用いられ、たとえば、チオカルバモ イル、N-メチルチオカルバモイル、N-フェニルチオ カルバモイルなどが用いられる。

【0012】 「曹挽されていてもよいCo-10アリールー メチル基1 としてはたとえば、ハロゲン、ニトロ、C ...アルキル、C1-sアルコキシなどから選ばれた1~3 個の電機基準管機されていてもよいCs-10アリールーメ チル基が用いられ、具体的にはたとえば、ベンジル、ナ フチルメチル, pーメチルベンジル, pーメトキシベン ジル、ロークロロベンジル、ローニトロベンジルなどが 用いられる。 『微棒されていてもよいジCo-10アリール - メチル基」としてはたとえば、ハロゲン、ニトロ、C ...・アルキル、C1-eアルコキシなどから遊ばれた1~3 鋸の電機基で置換されていてもよいジC。-10アリールー メチル基が用いられ、具体的にはたとえば、ベンズヒド リル、ジ (p-トリル) メチルなどが用いられる。「置 独されていてもよいトリCo-10アリールーメチル基」と してはたとえば、ハロゲン、ニドロ、C1-6アルキル。 C...アルコキシなどから遊ばれた1~3個の個換基で 置機されていてもよいトリCs-10アリールーメチル基が 用いられ、具体的にはたとえば、トリチル、トリ(ロー トリル) メチルなどが用いられる。「産換されていても よいCs-10アリールーメチレン基」としてはたとえば、 ハロゲン、ニトロ、C:-4アルキル、C:-4アルコキシな どから養ばれた1~3個の體操薬を置換されていてもよ いCs-10アリールーメチレン基が用いられ、具体的には たとえば、ベンジリデン、p-メチルベンジリデン、p - クロロペンジリデンなどが用いられる。「置換されて いてもよいCs-10アリールチオ基」としてはたとえば、 ハロゲン、ニトロ、Citaアルキル、Citaアルコキシな どから遊ばれた1~3個の屋檐葉で屋飾されていてもよ いて4・10アリールチオ基が用いられ、具体的にはたとえ ば、ローニトロフェニルチオなどが用いられる。

【0013】「電機シリル基」は保護されるアミノ基と あわさって式R*R*R*SiNH-, (R*R*R*Si)₂N -または

$$Z \stackrel{\text{Si}(R^{\bullet}R^{1\bullet})}{\sim} N - Si(R^{\bullet \circ}R^{1\bullet \circ})$$

(式中、R*,R*,R*,R*,R*)。R** および尽いはそれぞれて:。アルキル高またはて。。。アリール高を、2*はて、1。アルキレン高(メチレン、エチレン、プロピレンなど)を示す) で表わされるような高を形成する。「置機り別高」の好ましい例としてはたとえば、トリメチルシリル、1ctープチルジメチルシリル、- SI(CH₁)。
CH₁CH₁SI(CH₁)。- などが用いられる。「2 - C

1-10アルコキシーカルポニルー1ーメチルー1ーエテニ ル基」として具体的にはたとえば、2-メトキシカルボ ニルー1-メチルー1-エテニル、2-エトキシカルボ ニルー1・メチルー1・エテニル・2・tertープトキシ カルポニルー1-メチルー1-エチニル、などが用いら れる。M' で示される「アルカリ金属」としてはたとえ ば、ナトリウム、カリウムなどが好ましく、特にナトリ ウムなどが好ましい。 Ri は抗糖症性からみてアミノ基 が好生しい。

【0014】R¹は水素原子または炭素原子を介して結 合する基を表す。R:で表される「炭素原子を介して結 合する薬」としてはたとまば、層動されていてもよい炭 化水素基(例えば、黄穂されていてもよいアルキル基。 置接されていてもよいアルケニル基、置銭されていても よいアルキニル基、面換されていてもよいアラルキル 某、嚴格されていてもよい環状機化水業基)、アシル基 または後春原子に結合拝を有する機構されていてもよい 非労糧能存業器殊などが好ましく。特に、管理されてい てもよいアルギル構造機されだわてもよいアルケニル 基、機様されていてもよい環状機化水素基などが好まし い。「憧憺されていてもよいアルギル基」の「アルキル 差」としてはC:-*アルキル基ねむが好ましく、特にメ チル、エチル、イソプロビルなどが好ましい。「置機さ れていてもよいアルケニル基」の『アルケニル基』とし てはCz・6アルケエル基本どが好ましい。「置換されて いてもよいアルキにル葉』の「アルキニル菜」としては Co. アルキエル基本どが好ましい。「世換されていて もよいアラルキル棋。Iの「アラルキル茶」としてはC 2-10 アラルキル基体どが好ましい。「世換されていても よい環状炭化水素膳」の『環状炭化水素基』としてはた とえば、シクロプロピル! シクロプチル, シクロペンチ ル、シクロヘキシル、シクロヘプチル、2-シクロペン テン-1-イル、3-シャロペンサン-1-イル、2-シクロヘキセン-1-イル、3-シクロヘキセン-1-イルなどの3~7員非芳袋族環状鋭化水素基などが挙げ られ、特にシクロプチル、シクロペンチルなどのCs-r シクロアルキル基などが好ましい。「アシル基」として はたとえば、R! で示される「保護されていてもよいア ミノ茶」における保護薬として例示した「懺換されてい てもよいCi-oアルカノイル基」、「置換されていても よいCa・アルケソイル基」、「職機されていてもよい C-10アリールーカルボニル基」。「複素環カルボニル 其しなどが挙げられる。「淡素原子に結合手を有する置 換されていてもよい非芳香族複素類基」の「非芳香族複 素環基」としてはたとえば、オキシラニル、アゼチジニ ル、オキセタニル、チエタニル、ピロリジニル、テトラ ヒドロフリル、チオラニル、ピベリジル、テトラヒドロ ピラニル、モルホリニル、チオモルホリニルなどの炭素 原子以外に窒素原子、酸素原子、硫黄原子などのヘテロ

などが好ましい。

【0015】前記「段化水業基」が有していてもよい層 換基としてはたとえば、複素機基、水酸基、C1-eアル コキシ基、Cs-10シクロアルキル、Cs-1シクロアルキ ルオキシ基、C6-10アリールオキシ基、C7-19アラルキ ルオキシ基、複素環オキシ基、メルカプト基、C1-4ア ルキルチオ基、Cs-soシクロアルキルチオ基はCs-soア リールチオ基、C+-1eアラルキルチオ基※複素理チオ 基、アミノ基、モノC:-。アルキルアミノ盛、ジC:-。ア 10 ルキルアミノ基、トリC1-4アルキルアンモニウム基、 Cs-10シクロアルキルアミノ薬、Cs-10アリールアミノ 基.: C7-19 アラルキルアミノ基. 複楽理アミノ基. 環状 アミノ基、アジド基。ニトロ基、ハロゲン原子・シアノ 基、カルポキシル基、C1-10アルコキシーカルポニル 基: Co-10 アリールオキシーカルポニル基: Cr-19 アラ ルキルオキシーカルボニル基。Cs-10アリールーカルボ ニル語, Ci-6アルカノイル器, Ci-6アルケノイル基。 Cu-10アリールーカルポニルオキシ基、Co-4アルカノ イルオキシ茶、Cs-sアルケノイルオキシ茶、着機され ていてもよいカルバモイル基。最換されていてもよいチ オカルバモイル基、置機されていてもよいカルバモイル オキシ基、フタルイミド基、C1-6アルカノイルアミノ 基、Cs-10アリールーカルポニルアミノ基、Cs-10アル コキシーカルボキサミド基、Cs-1oアリャルオキシーカ ルポキサミド基、Cr-19アラルキルオキシーカルポキサ ミド基などが挙げられ、同一または異なって1ないし4 個存在していてもよい。

【0016】前記「炭化水震薬」の置換薬の具体例のう ち、「置換されていてもよいカルバモイル基」としては 30 たとえば、C1-6アルキル基, C6-10アリール基, C1-6 アルカノイル基、Cs-toアリールカルポニル基、Ct-s アルコキシーフェニル基などから選ばれた1または2個 の置換基で置換されていてもよいカルバモイル基および 環状アミノカルボニル基などが用いられ、具体的にはた とえば、カルパモイル、N-メチルカルパモイル、N-エチルカルバモイル, N, N-ジメチルカルバモイル, N, N-ジエチルカルパモイル、N-フェニルカルパモ イル、N-アセチルカルパモイル、N-ベンゾイルカル パモイル、N- (p-メトキシフェニル) カルパモイ 40 ル、ピロリジノカルポニル、ピペリジノカルポニル、ピ ベラジノカルポニル、モルホリノカルポニルなどが用い られる。「置換されていてもよいチオカルパモイル基」 としてはたとえば、C1-aアルキル基、Ca-1aアリール 基などから選ばれた1または2個の置換基で置換されて いてもよいチオカルパモイル基が用いられ、たとえば、 チオカルバモイル、N-メチルチオカルパモイル、N-フェニルチオカルバモイルなどが用いられる。「置換さ れていてもよいカルバモイルオキシ基」はたとえば、C 1-6アルキル基、C1-10アリール基などから選ばれた1 原子を1または2個含む3ないし6個非芳香族複素環集 50 または2個の電機基で電換されていてもよいカルバモイ

ルオキシ基が用いられ、具体的にはたとえば、カルバモ イルオキシ、Nーメチル対映がモイルオキシ、N、Nー ジメチルカルバモイルオキシ、N トエチルカルバモイル オキシ、N ーフェニルカルバモイルオキシなどが用いら オキシ、N ーフェニルカルバモイルオキシなどが用いら

【0017】「俠化水来湯」の電換器における複素類 蒸、機業調本を少高、機業職等する出よび模案領支之 素の複素調器としては、一部記、複換領力ルポエル器」に おける複楽調器との場が部が利いられる。 肉に「電換き れていてもよいアルキル器」の「アルケエル器」を 置換されていばでもよいアルケエル器」の「アルケエル器」が 置換されていばでもよいアルケエル器」の「アカウエル器」の 「理検されていばでもよいアルケエル器」の「アラルキル 基」および「電換されていてもよい調軟線化水薬器」の 「環状後化水薬器」が著していてもよい運動線として は、たとえば卵化の「調査されていてもよい運動線として は、たとえば明に「調査されていてもよい運動線として な、たと、1000円に関連されていてもよりである。 の「炭化水素器」が増していてもよい運動線ととして な、たと、1000円に関連されていてもよりで のたが用いられる、1000円で開発を手を有する 電換されていて地はいが排準測域無調差」の置換器として では、1000円に関値されていてもよい、単位水薬器」におい でのほどが用いられる、1000円に関値を手を有する 電換されていて地はいが排準測域無調差」の置換器として では、1000円に関値されていてもよい、単位水薬器」におい でのほどの形成りに関値されていてもよりに対象があげられる。

[0018] R*としては、「屋換されていてもよい炭 化水素基」などが好ましく、たとえば水酸基。Cs-10シ クロアルキル基。C:-。アルゴキシ基、C:-。アルキルチ オ基、アミノ基、ハロゲン原子、カルポキシル基、C 1-10 アルコキシ内ルポニル語、蜃機されていてもよいカ ルバモイル基、シアノ基、アジド基、複楽機基などから 表はれた1ないし3個の電視器で最後されていてもよい Cioアルキル基などであり、具体的には、シクロプロ ピルメチル、メトキシメチル、エトキシメチル、1-メ トキシエチル、2-メトギシエチル、1-エトキシエチ ル、2-ヒドロキシエチル、メチルチオメチル、2-ア ミノエチル、フルオロメチル、2 - フルオロエチル、 2,2-ジフルオロゴチル、クロロメチル、2-クロロ エチル、2,2ージグロロエチル、2,2,2ートリクロ ロエチル、2-プロモエチル、2-ヨードエチル、2、 2、2-トリフルオロエチル。カルボキシメチル、1-カルポキシエチル、2-カルポキシエチル、2-カルポ キシプロピル、3-カルポキシプロピル、1-カルボキ シブチル シアノメチル、1-カルポキシ-1-メチル エチル、メトキシカルポニルメチル、エトキシカルポニ ルメチル、tert-プトキシカルポニルメデル、1-メト キシカルポニルー1-メチルエチル、1-エトキシカル ポニルー1 - メチルエチル、1+teft-プトキシカルボ ニルー1-メチルエチル、1-ベンジルオキシカルポニ

14

ルー1-メチルエチル、1-ビパロイルオキシカルポニ ルー 1 – メチルエチル,カルバモイルメチル.N – メチ ルカルパモイルメチル、N.N-ジメチルカルバモイル メチル、2-アジドエチル、2-(ピラゾリル) エチ ル、2- (イミダゾリル) エチル、2- (2-オキソビ ロリジン-3-イル) エチル、1-カルボキシ-1-(2,3,4-トリヒドロキシフェニル) メチルなどが挙 げられる。R²として最も好ましいものは、たとえばメ チル エチル n = プロピル、イソプロピル、プチル。 イソプチル、sec-ブチル、フルオロメチル、2-フル オロエチル、2-クロロエチル、2-ヒドロキシエチ ル、2-メトキシエチル、シアノメチル、カルボキシメ チル、メトキシカルポニルメチル、エトキシカルポニル メチル、カルバモイルメチル、N-メチルカルパモイル メチル、N: N - ジメチルカルパモイルメチルなどのハ ロゲン、水散基、C:-oアルコキシ基、カルポキシル 基...C1-10アルコキシカルポニル基。シアノ基およびカ ルパモイル集から帯ばれた1ないし3個の衝換基で置換 されていてもよい直鎖状または分枝状のじょ。アルキル 其 シクロプロビル、シクロプチル、シクロペンチルな どのC1-5シクロアルキル基、シクロプロピルメチルな どのC3-5シクロアルキルーC1-3アルキル基などが挙げ られる。特に個換されていてもよいCi-sアルキル基お よびCx-sシクロアルキル基が好ましい。

[0019] R:およびR・は一方が優積されていてもよいビリジニウム基を、他方が水素原于または置換されていてもよい終化水素基を示すか、あるいはR:およびR・は互いに結合して4級化した望素原子を含む魔狼されていてもよい複素類を示す。「魔挽されていてもよいとリジニウム器」としては、たとえば式

(R)_p

「(式中、R⁵ は置換されていてもよい故化水楽等を、R はC_{1・6} アルキル基。C_{1・8} アルコキシ萬、C_{1・8} アルコ キシーカルボニル基。ア≥1、ニトロ、ハロゲンまたは カルボキシを、pは0ないし4の整数をそれぞれ示す) で表される基などが削いられる。R⁵およびR^{*}が互いに 結合して4 酸化した窒素原子を含む置換されていてもよ は複素機を示す場合。

[ft16]

T#:151

$$\sum_{S}^{15} \binom{R^3}{R^4}$$

(式中、gは0ないし3の整数を、その他の記号は前記 と同意義を示す)で表される6員不飽和複素環などが用 いられる。R*、R*またはR*で示される「置換されて いてもよい炭化水素基」としては、R2で示される「炭 **幸順子を作して結合する基」において制示した「曹操さ** れていてもよい炭化水素基」と同様のものが用いられ る。pおよびqは、それぞれOが好ましい。Rºとして は、メチルなどのC:-,アルキル基などが好ましい。R³ およびR+としては、R3が置接されていてもよいピリジ*

*ニウム基で、R*が水素原子であるか、あるいはR*およ びR・が互いに結合して4級化した窒素菓子を含む6員 不飽和複素環を形成する場合などが好ましい。

【0020】QおよびXはそれぞれ窒素原子またはCH を示す。QおよびXはそれぞれ會奏原子が好ましい。Y はS、OまたはCH2を示す。YはSが好ましい。すな わち、化合物 (I) としては (I') 【化17】

(式中の配号は前配と同意義を示す。) で表される化合 物またはそのエステルあるいはその塩が好ましい。nは 0または1を示すが、1であるのが好ましい。

* [0021] [/k.18]

前記化合物 [1] において4位の−COOの右翼に付した⊖はカルボキシル基 がカルボキシレートアニオンになったものであり化合物 [1] の3位の複素環 (以下A甲と略称することがある)

上の陽電荷と一対になって分子内塩を形成していること を示す。一方、化合物 [1] は業理学的に受容されるエ る塩としては無機塩基塩、アンモニウム塩、有機塩基 塩、無機酸付加塩、有機酸付加塩、塩基性アミノ酸塩な どが用いられる。無難塩基塩を生成させうる無機塩基と してはアルカリ金属(たとえばナトリウム、カリウムな ど) アルカリ土類金属(たとえばカルシウムなど)など が、有機類基塊を生成させうる有機塩基としてはたとえ ばプロカイン、2-フェニルエチルベンジルアミン、ジ ベンジルエチレンジアミン, エタノールアミン, ジエタ ノールアミン、トリスヒドロキシメチルアミノメタン。

ンなどが、無機酸付加塩を生成させうる無機酸としては たとえば塩酸、臭化水素酸、硫酸、硝酸、リン酸など ステルまたは極を形成してもよい。薬理学的に受容され 40 が、有機酸付加塩を生成させうる有機酸としてはたとえ ばヮートルエンスルホン酸! メタンスルホン酸, ギ酸, トリフルオロ酢酸、マレイン酸などが、塩基性アミノ酸 塩を生成させうる塩基性アミノ酸としてはたとえばリジ ン、アルギニン、オルニチン、ヒスチジンなどが用いら れる。これらの塩のうち塩基塩(すなわち無機塩基塩、 アンモニウム塩、有機塩基塩、塩基性アミノ酸塩) は化 合物 [1] の置換基 R1、 R2、 R5 中にアミノ基、モノア ルキルアミノ基、ジアルキルアミノ基、シクロアルキル アミノ基、アリールアミノ基、アラルキルアミノ基、環 ポリヒドロキシアルキルアミン、N-メチルグルコサミ 50 状アミノ基、含窒素複素環基などの塩基性基が存在する

場合に形成しうる酸付加塩を意味する。また酸付加塩と *【化19】 しては *

化合物 []] の分子内閣を形成している部分、すなわちも位のカルボキシレート部分(COO^Θ)と3位の $+CH=CH3\pi_S - A \Theta 部分に触が1 そル付加して4位がカルボキシル基(<math>COO(H)$)、3位が $+CH=CH3\pi_S - A^\Theta 2\Theta$ ($気中、<math>2\Theta$ は無機能、有額能からプロトン H^Θ をとりのぞいてできるアニオンを表す)

たとえばクロライドイオン、プロマイドイオン、スルフェートイオン。 p ートルエンスルホネートイオン、メタ 10 スルホネートイオン・イオン ンスルホネートイオン ウェー カーオー カーオー カーボー かった とじ となった 塩も含まれる。 化合物 (1) のエステル 開導体は分子中に含まれるカルボキシル基をエステル化 オスェンドにより年度される あエステルを 義味し、 合成中

誘導体は分子中に含まれるカルボキシル基をエステル中 することにより生成されるカエステルを意味し、合成で 間等のエステルである。合成や可像はして利用できるエス テルとしては最適されていてもない。 テルとしては最適されていてもない。「Cs・・・・アルキルエス テル、Cs・・アルケニルエステル。「Cs・・・アルキルエス テル、Cs・・アルケニルエステル。「Manary アルキルエス アル 異様されていてもよいCs・・・アルキルエステル。ジC ・・・・アリールーメチルエステル、ドリCs・・・アリールーメチルエステル、便様シリルエステルなどが用いられていていた。 ・・・・アリールーメチルエステル、トリCs・・・・アリールーメチルエステル、便様シリルエステルなどが用いられていた。

【0022】「置換されていてもよいC1-4アルキルエ ステル」としては、たとえばメチル、エチル、n-プロ ヒル, イソプロヒル, n-ブチル, イソブチル, sec-プチル、tertープチル、nーベンチル、nーヘキシル等 が用いられ、それらは例えば、ペンジルオキシ、Ci-4 アルキルスルホニル(例、メチルスルホニル等)、トリ メチルシリル、ハロゲン(例、フッ素、塩素、臭素 等) アセチル、ニトロペンゾイル、メシルペンゾイ ル、フタルイミド、サクシンイミド、ペンゼンスルホニ ル、フェニルチオ、ジC···アルキルアミノ(例、ジメ チルアミノ等)、ヒリジル、C:・・アルキルスルフィニ ル (例、メチルスルフィニル等), シアノ等で1~3個 置換されていてもよく、そのような甚としては具体的に は例えば、ベンジルオキシメチル、2 ーメチルスルホニ ルエチル、2 コトリメチルシリルエチル、2,12,2-ト リクロロエチル、2-ヨードエチル、アセチルメチル、 p - ニトロベンゾイルメチル。 p + メシルベンゾイルメ チル, フタルイミドメチル, サクシンイミドメチル, ベ ンゼンスルホニルメチル, フェエルチオメチル, ジメチ ルアミノエチル、ビリジン・1 -オキシド・2 - メチ ル、メチルスルフィニルメ研ル、2-シアノー1,1-ジメチルエチルなどが用いわれる。「C:-。アルケニル エステル」を形成するCz-oアルケニル基としてはピニ ル、アリル、1-プロベニル、イソプロベニル、1-ブ テニル、2-プテニル、3-プテニル、メタリル、1。 1-ジメチルアリル、3-メチル-3-ブテニルなどが 50

用いられる。

用いられる。
[0023] 「C3・11 シクロアルキルエステル」を形成
するC3・12 シクロブルキル基としてはシクロブロビル、
シクロブチル、シクロベンチル、シクロベキシル、シク
ロベブチル、シクロベンチル、シクロベキシル、シク
ロベブチル、ファットル、シクロスシールなどが用いられる。「C3・12 シクロアルキルC1・17 アルキルエステ
としてはシクロプロビルメチル、シクロベンチルメチ
ル、シクロベキシルメチルなどが用いられる。「産業会
れていてもよいC1・17 リールエステル)を形成する
「C4・17 リール基」としてはたとえばフェニル。αー
ナフチル、βーナフチル、ビフェニコル等が用いられ、塩
カフェル、βーナフチル、プロゲン(M) フッ素、αー
オフチル、βーナストと「10 ログン・ストー
は、10 ログン・ス

18

【0024】「置換されていてもよいC1.12アラルキル エステル」を形成する「C1-12アラルキル基」としてはた とえば、ペンジル、1-フェニルエチル、2-フェニル エチル、フェニルプロピル、ナフチルメチル等が用いら れ、それらは例えば、ニトロ、C1-4アルコキシ(例、 メトキシ等), C1-4アルキル (例、メチル, エチル 等), ヒドロキシで1~3個世換されていてもよく、そ のような基として具体的には例えば、p-ニトロベンジ ル、p-メトキシベンジル、3.5-ジtert-ブチルー 4-ヒドロキシベンジルなどが用いられる。「ジCs-10 アリール-メチルエステル」を形成するジCs-10アリー ルーメチル基としてはペンズヒドリルなどが、トリC 6-10 アリールーメチルエステルを形成するトリC₀-10 ア リールーメチル基としてはトリチルなどが、置換シリル エステルを形成する置換シリル基としてはトリメチルシ リル、tert-プチルジメチルシリル。-Si(CHa)2C H: CH: Si(CH:): -などが用いられる。前記したエ ステルには4位のエステルも含む。このように4位が前 配のエステル基であるものは3位に式 IK201

$+CH=CH+_{\overline{n}}S-A\Theta_{\overline{Z}}\Theta$

(式中の記号は前記と同意義を示す)で表される基を有 する塩を形成している。

【0025】本発明は前記エステル誘導体のほかに、生体内において化合物 [1] に変換される薬理学的に受容

しうる化合物も包含する。本発明の化合物 (1) および 原料化合物のn = 1の場合においては、シス異性体 (乙 体)、トランス異性体 (豆体) およびシス、トランス混 台物が包含されるものとする。本発明の化合物 (7) は、トランス異性体 (巨体) が好まじむ。化合物 (1) については、何光ばシ沢異性体 (②体) は式 (XVII)

[Kt 2 1] S-A (XVII)

で表わされる部分構造を有する機何異性体の1つを意味 し、トランス異性体は式〔XVIII〕

[(£22] B S-A⊕ [XVIII]

で表わされる部分構造を有する幾何異性体を意味する。 [0026] 本職項服書において特に明記されていない 場合の各置換基の異体例は次の通りである。

ハロゲン: フルオロ、クロロ、プロモ、ヨードなど; C1-4アルキル基: メチル、土チル、プロピル、イソブロピル、ブチル、イソブチル、t ーブチルなど;

ロビル、フチル、イソフチル、モーフチルはこ; C1-4アルキル基:上配C1-4アルキル基及びペンチル、 2.2-ジメチルプロビル、ヘキシルなど;

 C_{2+} \mathcal{P} \mathcal{N} \mathcal{P} \mathcal{N} \mathcal{N}

Cs sシクロアルキル基: シクロプロピル、シクロプチル、シクロペンチルなど;

C₃₋₁₆シクロアルキル基:上配C₃₋₅シクロアルキル基 及びシクロヘキシル、シクロヘブチル、シクロオクチル、シクロデシルなど:

Co-10アリール基:フェニル、ナフチルなど;

C₇₋₁₀アラルキル基:ペンジル、1-フェニルエチル、 2-フェニルエチル、フェニルプロピル、ナフチルメチル、ペンズヒドリルなど:

【0027】 C,...。アルコキシーカルポニルオキシ基: メトキシカルポニルオキシ、エトキシカルポニルオキシ、エトニンカルポニルオキシ、tert-ブトキシカルポニルオキンなど;

C1-4アルコキシ書: メトギシ、エトキシ、プロポキシ、イソプロボキン、プトキシ、イソプトキシ、t ープトキシ、ペンチルプロピルオキシ、ス・2 - 2 - ジメチルプロピルオキシ ヘキシルオキシなど:

Cュ・シクロアルキルオキジ書:シクロプロピルオキシ、シクロプチルオキシ、シクロペンチルオキシ、シクロペンチルオキシ、シクロペキシルオキシなど:

20 Co-10 アリールオキシ墓: フェノキシ、ナフチルオキシ など;

C₇₋₁₉ アラルキルオキシ基:ペンジルオキシ、1-フェ ニルエチルオキシ、2-フェニルエチルオキシ、ペンズ ヒドリルオキシなど:

【0028】 C:-・アルキルチオ基: メチルチオ、エチ ルチオ、プロビルチオ、ブチルチオ、イソブチルチオ、 t ー ブチルチオ、ペンチルチオ、2,2ージメチルプロ ビルチオ、ヘキシルチオなど:

C₆₋₁₆アリールチオ基:フェニルチオ、ナフチルチオなど:

C₇₋₁₉アラルキルチオ基:ペンジルチオ、フェニルエチルチオ、ペンズヒドリルチオ、トリチルチオなど:

C:-(アルキルスルフィニル語:メチルスルフィニル、 エチルスルフィニル、プロピルスルフィニル、イソプロ ピルスルフィニル、プチルスルフィニル、tープチルス

20 ピルスルフィニル、プチルスルフィニル、tープチルス ルフィニルなど; C1-4アルキルスルホニル甚:メチルスルホニル、エチ

 C_{1-a} アルギルスルボニルを: メデルスルボニル、エデルスルボニル、プロピルスメルボニル、イソプラルスルボニル、t = ブチルスルボニル、t = t =

30 ジC₁₋₄ アルキルアミノ甚:ジメチルアミノ、ジエチル、アミノ、メチルエチルアミノ、ジー(n-プロビル)アミノ、ジー(n-プロビル)アミノなど:

 \mathcal{C}_{1-n} アルキルアミノ基: 上記ジ C_{1-n} アルキルアミノ 基及びジ (ペンチル) アミノ、ジ (n-ヘキシル) アミ ノなど:

トリC₁₋₄アルキルアンモニウム基:トリメチルアンモニウムなど;

C₁-ioシクロアルキルアミノ基:シクロプロピルアミ ノ、シクロベンチルアミノ、シクロヘキシルアミノな 0 ど:

Cs-10 アリールアミノ基:アニリノ、Nーメチルアニリ ノなど:

C₇₋₁₉ アラルキルアミノ**あ**: ベンジルアミノ、1 - フェニルエチルアミノ、2 - フェニルエチルアミノ、ベンズヒドリルアミノなど;

環状アミノ基: ピロリジノ、ピペリジノ、ピペラジノ、 モルホリノ、1 - ピロリルなど;

C1-6アルカノイルアミノ基:アセトアミド、プロピオ ンアミド、ブチロアミド、パレロアミド、ピパロアミド 50 など:

(C) 2000 Copyright Derwent Information Ltd.

C₆₋₁₀アリールーカルポニルアミノ蓋:ペンズアミド、 ナフトイルアミド、フタルイミドなど;

【0030】C;・・アルカノイル基: ホルミル、アセチル、プロピオエル、プチリル、パレリル、ピパロイル、サクシニル、グルタリルなど;

C: *アルカノイルオキシ書:アセトキシ、プロピオニ ルオキシ、プチリルオキシ、パレリルオキシ、ピパロイ ルオキシなど:

C:-:oアルカノイルオキシ甚: 上配C:-oアルカノイル オキシ甚及びホルミルオキル; ヘキサノイルオキシ、ヘ 10 プタノイルオキシなど;

Cs.sアルケノイル基:アクリロイル、クロトノイル、 マレオイルなど:

Cs-sアルケノイルオキシ基:アクリロイルオキシ、クロトノイルオキシ、マレオイルオキシなど;

ロトノイルオキシ、マレオイルオキシなど; C₄₋₁₀ アリールーカルポニル基:: ベンゾイル、ナフトイ

ル、フタロイル、フェニルアセチルなど; C₆₋₁₆アリールーカルポニルオキシ蓋;:ベンソイルオキシ、ナフトイルオキシ、フキニルアセトキシなど;

C1.*アルコキシーフェニル第:(メトキシフェニル、エ 20 トキシフェニル、プロポキシフェニル、プトキシフェニ ル、t-プトキシフェニルなど:

ど: C1-10 アルコキシーカルポニルオキシ幕 《メトキシカル ボニルオキシ、エトキシカルポニルオキシ、プロポキシ カルポニルオキシ、イソプロポキシカルポニルオキシ、 ブトキシカルポニルオキシ、イソプトキシカルポニルよ キシ、トープトキシカルポニルオキシ、カルポニル カルポニルオキシ、2.2 ージメチルプロピルオキシカ ルポニルオキシ、ヘキシルオキシカルポニルオキシ、ヘ ブチルオキシカルポニルオキシ、デシルオキシカルポニ ルオキシカルポニルオキシ、デシルオキシカルポニ

C3-18シクロアルキルオキシーカルボニル基:シクロブ 40 ロビルオキシカルボニル、シクロブチルオキシカルボニ ル、シクロンチルオキシカルボニル、シクロへキシル オキシカルボニル、シクロへブチルオキシカルボニル、 シクロオクチルオキシカルボニル、シクロデシルオキシ カルボニルなど:

C_{3・10}シクロアルキルオキシーガルボニルオキシ番:シ クロプロピルオキシカルボニルオキシ、シクロプテルオ キシカルボニルオキシ、ジクロペンチルオキシカルボニ ルオキシ、シクロへギンルオポールオキン、シ クロペブチルオキシカルボニルオキシ、シ

オキシカルポニルオキシ、シクロデシルオキシカルポニ ルオキシなど:

[0032] Cs-16 架橋環式技化水素オキシーカルボニル高: ノルボルニルオキシカルボニル、アダマンチルオキシカルボニルなど:

C2-14 アルケエルオキシーカルボエル基: アリルオキシカルボニルなど:

C₆₋₁₀アリールオキシーカルポニル基:フェノキシカル ポニル、ナフチルオキシカルポニルなど

Co-10 アリールオキシーカルポキサミド基:フェノキシ カルポキサミド(CoHsOCONHー)など;

C:-:o アラルキルオキシーカルポキサミド甚:ペンジルオキシカルポキサミド (Co Ho C Ho O C O N H ー) 、ペンズヒドリルオキシカルポキサミドなど;

(0033)本発明の化合物(I)の製造法を以下に詳しく述べる。

製造法(1):たとえば式〔11〕

(式中の配号は前配と同意義を示す。)で表わされる?アミソ化合物またはそのエステルあるいはその塩と式(111)

(式中の記号は前配と同意義を示す。) で表わされるカ ルポン機またはその塩あるいはその反応性誘導体とを反 応させることにより化合物 [1] を合成することができ ス

【0034】本法は?ーアミノ化合物(II)をカルボン 館(III)またはその堪あるいはその反応性誘導体でア シル化する方法である。この方法においてカルボン酸 (III)は遊離のまま、またはその塩あるいはその反応 性誘導体が?ーアミノ化合物(II)の?位アミノ基のア シル化剤として用いられる。すなわち遊離酸(III)ま たは避離腹(III)の無機堪基塩、複視塩基塩、酸?コ イド、微サジド、酸無水物、混合酸無水物、低任アミ ド、活性エステル、維性多本に大工ステルなどの反応性誘導ル 体がアシル化反応に供される、無機堪高塩としてはアル

20

カリ金属塩 (たとえばナトリウム塩、カリウム塩な ど)、アルカリ土類金属塩(たとえばカルシウム塩な ど) などが: 有機塩基塩としてはたとえばトリメチルア ミン塩、トリエチルアミン塩、tert-プチルジメチルア ミン塩、ジベンジルメチルアミン塩、ベンジルジメチル アミン塩、N、Nージメチルアニリン塩、ビリジン塩、 キノリン歯などが、酸ハライドとしてはたとえば酸クロ ライド、酸プロマイドなどが、混合酸無水物としてはモ ノC、アルキル炭酸混合酸無水物 (たとえば遊離酸 (1 [[] とモノメチル炭酸、モノエチル炭酸、モノイソプロ ビル炭酸 モノイソブチル協構、モノtertープチル炭 酸、モノベンジル炭酸、モノ(p-ニトロベンジル)炭 酸、モノアリル炭酸などとの混合酸無水物)、 C1-6 脂 肺族カルボン酸混合融無水物(たとえば遊離酸〔III〕 と酢酸、トリクロロ酢酸、シアノ酢酸、プロビオン酸、 略論、イツ略論、密草機: イジ吉草酸、ビバル酸、トリ フルオロ酢酸、トリクロ中酢酸、アセト酢酸などとの提 合酸無水物) . C1-12 芳香族カルボン酸混合酸無水物 (たとえば遊離酸 [III] と安息番離、pートルイル 酸、p-クロロ安息香酸などとの融合酸無水物),有機 スルホン酸混合酸無水物(たとえば遊離酸〔III〕とメ タンスルホン酸、エタンスルホン酸、ペンゼンスルホン № n-トルエンスルホン酸などとの配合酸無水物)な どが、活性アミドとして准含窒素健康現化合物とのアミ ド(たとえば遊離数 [111] とピラゾール、イミダゾー ル、ベンソトリアソールなどとの酸アミドで、これらの 含窒素複素現化合物はCiteアルキル基、Citeアルコキ シ某、ハロゲン、オキソ基、チオキソ基、C1-6アルキ ルチオ基などで置換されていてもよい。) などがあげら れる。活性エステルとしてはβ-ラクタムおよびペプチ ド合成の分野でこの目的に用いられるものはすべて利用 でき、たとえば有機リン酸エステル(たとえばジエトキ シリン酸エステル、ジフェノキシリン産エステルなど) のほか n ーニトロフェニルエステル、2、4 - ジニトロ フェニルエステル、シアノメチルエステル、ペンタクロ ロフェニルエステル, ドーヒドロキシサクシンイミドエ ステル、N-ヒドロキシフタルイミドエステル。1-ヒ ドロキシベンゾトリアゾールエステル、6-クロロ-1 - ヒドロキシベンゾトリアゾールエステル、1 - ヒドロ キシー1H-2-ピリドンエステルなどがあげられる。 活性チオエステルとしては芳香族産業環チオール化合物 とのエステル(たとえば・2 - ビリジルチオールエステ ル、2-ベンソチアソリルチオールエステルなどで、こ れらの複素環はC1-sアルキル基、C1-sアルコキシ基。 ハロゲン、Citeアルキルチオ基などで置換されていて もよい。〕が挙げられる。一方、7-アミノ化合物 [I は遊離のまま、その塩あるいはエステルとして用い られる。7-アミノ化合物 [II] の塩としては無機塩基 塩、アンモニウム塩、有機塩基塩、無機酸付加塩、有機

り命属権(たとえばナトリウム塩、カリウム塩など)。 アルカリナ器会属塩(たとえばカルシウム塩など) など が、有機塩基塩としてはたとえばトリメチルアミン塩、 トリエチルアミン塩、tertープチルジメチルアミン塩。 ジベンジルメチルアミン塩、ペンジルジメチルアミン 塩: N. N - ジメチルアニリン塩、ピリジン塩、キノリ ン塩などが、無機酸付加塩としてはたとえば塩酸塩、臭 化水素體塩、硫酸塩、硝酸塩、リン酸塩などが、有機酸 付加塩としてはギ酸塩、酢酸塩、トリフルオロ酢酸塩、 メタンスルホン酸塩、p-トルエンスルホン酸塩などが あげられる。7-アミノ化合物 (il) のエステルとして は化合物 [I] のエステル誘導体としてすでに述べたエ ステルがここでもそのままあげられる。すなわちC:-6 アルキルエステル、C2-aアルケニルエステル、C2-10 シクロアルキルエステル、Cs-6シクロアルキル-C1-6 アルキルエステル、Cs-10アリールエステル。Cr-12ア ラルキルエステル、ジー Co-10 アリールメチルエステ ル、トリーCs-10アリールメチルエステル、Cs-4アル カノイルオキシーC1-4アルキルエステルなどが挙げら れる。原料物質 [11]] 、その複及びその反応性器等体 は公知の方法 (例えば、特別昭60-231684号、 特開昭62-149682号等に配載の方法) またはそ れに集ずる方法によって容易に撃造できる。化合物「III 1) の反応性誘導体は反応混合物から単離された物質と しで7-アミノ化合物〔II〕と反応させてもよいし、ま たは巣҇離前の化合物(川川)の反応性精準体を含有する 反応混合動をそのまま7-アミノ化合物([1])と反応さ せることもできる。カルボン酸(III)を遊離酸または 塩の状態で使用する場合は高当な縮合剤を用いる。縮合 刺としてはたとえばN,N'-ジシクロヘキシルカルボ ジィミドなどのN, N'ージ債換カルポジイミド類, たと えばN.N'-カルポニルジイミダゾール、N.N'-チ オカルボニルジイミダゾールなどのアゾライド顛、たと えばN:-エトキシカルポニル-2-エトキシ-1,2-ジヒドロキノリン、オキシ塩化リン、アルコキシアセチ レンなどの脱水剤、たとえば2-クロロビリジニウムメ チルアイオダイド、2-フルオロビリジニウムメチルア イオダイドなどの2-ハロゲノビリジニウム塩類などが 用いられる。これらの総合剤を用いた場合、反応はカル ポン酸 [III] の反応性誘導体を経て進行すると考えら れる。反応は一般に密媒中で行なわれ、反応を阻害しな い溶媒が適宜に選択される。このような溶媒としてはた とえばジオキサン、テトラヒドロフラン、ジエチルエー テル、tert - ブチルメチルエーテル、ジイソプロピルエ ーテル、エチレングリコールージメチルエーテルなどの エーテル報、たとえば半腰エチル、酢酸エチル、酢酸n - プチルなどのエステル類。たとえばジクロロメタン、 クロロホルム、四塩化炭素、トリクレン、1,2-ジク ロロエタンなどのハロゲン化炭化水素類、たとえばn-酸付加塩などがあげられる。無機塩基塩としてはアルカ 50 ヘキサン、ベンゼン、トルエンなどの炭化水素類、たと えばホルムアミド、N.Nージメチルホルムアミド、N. N-ジメチルアセトアミドなどのアミド側。 たとえばア セトン、メチルエチルケトン、メチルイソプチルケトン などのケトン類。たとえばアセトニトリル、プロピオニ トリルなどのニトリル類などのほか、ジメチルスルホキ シド、スルホラン、ヘギサメチルホスホルアミド、水な どが単独変なは最高複雑として用いられる。アシル化剤 [HI] の使用量数7-アキジ化合物(N) 1モルに対 して遊客約1~5モル、健康しくは約1~3モルであ る。反応は約-80~80℃、好ましくは約-40~5 0℃、最も好ましくば約→3/0~30℃の温度範囲で行 われる。反応時間は7.4万ミノ化合物 [11] およびカル ポン酸 [[11] の種類 溶薬の種類 (混合溶媒の場合は その混合比も) 、反応温度などに依存し、通常約1分~ 72時間、好ましくは約15分~10時間である。アシル化剤 として酸ハサイドを用いた場合は放出されるハロゲン化 水素を反応系から除去する目的で設職剤の存在下に反応 を行うことができる。このような脱穀剤としてはたとえ ば厳酸ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸カルシウム、炭 酸水素ナトリウムなどの機構塩基。 たとえばトリエチル アミン、トリ (nープロ組成) アミン、トリ (nープチ ル) アミン、ジイソプロピルエチルアミン、シクロペキ シルジメチルアミン、ピッシン、ルチジン、ャーコリジ ン, N, N - ジメチルアニリン, N - メチルピペジリ ン, N-メチルピロリジン, N-メチルモルホリンなど の第3級アモンドたと先ばプロピレンオキシド、エピクキ *ロルヒドリンなどのアルキレンオキシドなどが挙げられる。

:[0035] 本反応の原料の7-アミノ化合物:(II) の うちY=Sである化合物もしくはそのエステルまたはそ の塩はたとえば、つぎのようにして得られる。まず式 (NII)

[#:25]

〔式中、R18はアミノ基の保護基、R13はカルポキシル 基の保護基、Lはハロゲン原子、低級アシルオキシ基、 または沢ルホニルオキシ基、その他の配号は前配と同意 最をはアルボニルオキシ基、その他の配号は前配と同意 最後にアル、3≈で表わされる化合物と式 (VIII)

(式中の配得は前記と同意義を示す。) で表わされるビリジン化合物またはその塩とを反応させて、式 (IX) (化27)

(式中の配号は前配と同意機を示す。) で表わされる化合物またはその概を製造し、ついで、例えば特別昭55 -154978などに配搬されている方法によりS-才※ ※キシドを還元して、式〔X〕 【化28】

$$\begin{array}{c}
\text{NH} \\
\text{OTALL} \\
\text{CH} = \text{CH} \\
\text{in} \\
\text{S}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
\text{R}^{3'} \\
\text{R}^{4'}
\end{array}$$
(1)

(式中の配号は前配上間意義を示す。) で表わされる化合物またはその集型製造する。つわで、化合物 (X) に、R*/またはR*(で示される業換されていてもよいとリジル基またはR*/が互いに結合して形★

★成される窒素原子を含む置換されていてもよい複素類中の窒素原子を4級化させる化合物(以下4級アンモニウム化剤という。)を反応させて式(XI) (化29]

〔式中の配号は前配と同意義を示す。〕で表される化合 50 物を得る。ついで必要により保護基を除去することによ

り化合物 (II) を製造できる。上記4級アンモニウム化 剤としてはたとえばR*-Z (R*は前記と両業機であ り、Zは脱離基を示す。) で扱わされる化合物が挙げら

【0036】 R12で示されるカルボキシ基の保護基としては、 的記のエステルが挙げられる。 特に、トリメチルシリル基等のトリ(低級)アルキルシリル基。 はては、アンドとドリル基、pーメトキシベンジル基、 Lett・プチル基・pーニトロペンジル基、フェナシル基等通常コの分野で用いられ、容易に除法し得るカルボキシ基の保護基が好ましい。

【0037】R11で示されるアミノ基の保護基として、 前紀のアミノ基の保護基が挙げられる。特に、トリメチ ルシリル基等のトリ(低級)アルキルシリル基、ホルミ ル基、トリフルオロアセチル基、アセチル基、tertープ トキシカルポニル基、メトキシアセチル基、ペンジルオ キシカルポニル基、p-エトロペンジルオキシカルポニ ル某等のアシル系保護基、ベンジル基、ベンズヒドリル 基、トリチル基等のアラルキル基系の保護基が好まし い。しは、クロル、プロム、ヨウ素等のハロゲン原子、 マセトキシ、プロピオニルオキシ、プチリルオキシ、3 オキソプチリルオキシ等のアシルオキシ基、メタンス ルホニルオキシ、エタンスルホニルオキシ等のアルキル スルホニルオキシ基、ペンゼンスルホニルオキシ、ナフ タレンスルホニルオキシ、pートルエンスルホニルオキ シ、p-tert-プチルベンゼンスルホニルオキシ、px トキシベンゼンスルホニルオキシ、p - クロロベンゼ ンスルホニルオキシ、D-ニトロペンゼンスルホニルオ キシ等のアリールスルホエルオキシ基が好ましい。特に ベンゼンスルホニルオキシ、pェトルエンスルホニルオ 30 キシ基が好ましい。 Z は脱離基を示すが、クロル、プロ ム、ヨウ素等のハロゲン原子等が好ましい。

【0038】 化合物 (VIII) は塩としても用いられる。
化合物 (VIII) の塩としてはたとえばリチウム塩、ナト
リウム塩、カリウム塩等のアルカリ金属塩、トリエチル
アミン、ジイソブロビルアミン等のトリアルキルアミン
との付加塩などがあげられる。化合物 (VIII) と化合物
(VIII) との求校置機反応は、通常アセトン等のケトン
新、クロロホルム、ジクロロメタン、ジクロロエタン等
のハロゲン炭化水素質、ジエチルエーテル、テトラヒド
ロフラン、ジオキサン等のエーチル類、アセトニトリル
等のニトリル類、メタノール、エタノール、ローブロバ
ノール等のアルコール類、ジメチルホルムアミド、ジメ チルアセトアミド等のアミド類、ジメチルスルホキシド 等のスルホキンド類などの不同性治療中で行なうの代い。
次核試験 (VIII) の使用量は化合物 (VII) 1モル
い。次核試験 (VIII) の使用量は化合物 (VII) 1モル
い。次核試験 (VIII) の使用量は化合物 (VII) 1モル

に対して通常1~5モル、好ましくは約1~3モルであ る。反応温度は-30℃~120℃、好ましくは-20 ℃~80℃である。反応は5分から24時間、好ましく は15~10時間で行なわれる。また、本反応は塩基や 塩類を添加することによって反応を促進させることがで 含る。これらの塩基、塩塩としては、例えば水酸化ナト リウム、水酸化カリウム、炭酸ナトリウム、炭酸カリウ ム等の無機塩基、トリエチルアミン、ジイソプロビルエ チルマミン集のトリアルキルアミンのような有機アミン 10. が挙げられる。また塩類としてはテトラプチルアンモニ ウム塩のような第4級アンモニウム塩等が用いられる。 【0039】化合物 [X] と反応させるR*Zで表わされ る化合物としては、例えばC1-4低級アルキルハライ ド、Co.a 低級アルケニルハライド、Co.a 低級アルキニ ルハライド、ヒドロキシ低級アルキルハライド、カルボ キシ低級アルキルハライド、カルパモイル低級アルキル ハライド、低級アルケノイル低級アルキルハライド等が 挙げられ、上記各種ハライドとしては、クロライド、ブ ロマイド、ヨーダイド等が挙げられる。化合物 (X) と 4級アンモニウム化剤との反応は過常ジクロロメタン、 ジクロロエタン、クロロホルム、四塩化炭素等のハロゲ ン炭化水素類、ペンゼン、トルエン、キシレン等の芳香 族炭化水素類、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラ ン、ジオキサン等のエーテル被、アセトニトリル等のニ トリル韜、メタノール、エタノール、n-プロパノール 等のアルコール類、ジメチルホルムアミド、ジメチルア **サトアミド等のアミド額、ジメチルスルホキシド等のス** ルホキシ類などの不活性溶媒中で行なうのがよい。 4級 アンモニウム化剤の使用量は1~50モル、好ましくは 5~20モルである。反応機能は0℃~120℃、好ま しくは15~100℃である。反応は0.5~48時 間、好ましくは、1~24時間で行なわれる。前配で得 られた化合物 (XI) から保護艦を除去するには、例え ば、保護基がトリ(低級) アルキルシリル基である場合 には、水で処理することにより行なうことができる。ま た、ペンズヒドリル基、トリチル基、p-メトキシペン ジル基、tertープチル基、tertープトキシカルポニル 基、ホルミル基等の保護基である場合には、半酸、塩 酸、トリフルオロ酢酸、酢酸、フェノール、クレゾール 概等で処理すれば除去できる。前記脱保護反応によりY =Sである7-アミノ体 [II] が得られる。

28

[0040] Y=Sである化合物 (I) はたとえば製造 法 (2) および (3) によっても製造される。 製造法 (2) :たとえば式 (XII)

化301

時期平9-100283

$$\mathbb{R}^{1} \xrightarrow{\text{COMB}} \mathbb{C}^{(0)} \mathbb{R}$$

$$\mathbb{C} = \mathbb{C} \mathbb{E}^{1} \mathbb{I}$$

$$\mathbb{C} = \mathbb{C} \mathbb{E}^{1} \mathbb{I}$$

$$\mathbb{C} = \mathbb{C} \mathbb{E}^{1} \mathbb{I}$$

[式中、mは0または1、その他の配寄は腑配と同意義 を示す。)で表わされる化合物と式(VEND)。

* (式中の記号は前記と同意義を示す。) で表わされる化 合物とを反応させ、式(XIII) 【化32】

[(231]

[[[]]]

$$\begin{array}{c|c} R_1 & COMB & COMB & CH = CH)^{\mu} C & R_{a_1} \end{array}$$

10

[式中の記号は前部と同意観を示す。] で装わされる化 20%で、式 (XIV) 合物を製造し、ついで4級アンモニウム化剤と反応させ※ [化33]

$$\begin{array}{c|c}
R^1 & CONB & CONB & X & R^5 \\
\hline
CONB & CONB & X & X
\end{array}$$
(X1Y)

[式中の配号は前配と同意義表示す] で表わされる化合 物を製造し、更に保護基を輸去することによる前記 (1) 記載の化合物の製造株。

【0041】化合物 (XII) と化合物 (Will) の求核圏 換反応は、製造法(1)の化合物 (VII) と化合物 (VII 1] との反応と関係の反応条件下に行うことができる。 化合物 [XIII] の4級アンモニガム化は、製造法(1) ★ **★の化合物 (X) と4級アンモニウム化剤との反応と同様** の反応条件下に行うことができる。かくして得られた化 合物 [XIV] は、製造法 (1) で示した方法により保護 基の除去を行なうことができ、式〔l〕の本発明化合物 が製造される。

【0042】製造法(3):たとえば式(XII) [4:34]

$$\begin{array}{c|c} & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & \\ & & \\ &$$

[式中の記号は前記と同意義を示す。] で表わされる化 合物と式 (XV)

化351

[式中の記号は前記と問意義を示す。] で表わされる化 合物とを反応させ、式 (XIV) [化36]

31
$$\begin{array}{c}
(0)_{m} \\
(0)_{m}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
(CH = CH)_{\overline{h}} S \\
(CH)_{\overline{h}} S$$

(式中の記号は前記と同意構を示す。)で表わされる化合物を翻造し、更に保積減を換去するだとを特徴とする 前紀-(*1) 記載の化合物の製造域。 化合物 (XII) と化合物 (XII) と化合物 (XIII) と化合物 (XIII) と化合物 (XIII) との反応は製造掛(*1) の化合物 (XIII) と化合物 (XIII) は、製造は、1)で未り上方法により保養等の除去を行なうことができ、式、(1) の本苑明化合物が製造される。

【0043】本製造法における化合物(XII) は、式(X

[化37]

(式中の記号は前配と同意機を示す。) で表される化合物と式 (111)

[化38]

(式中の記号は前配と同意輸を示す、) で表わされるカルボン酸またはその塩あるいはその皮のた時等体とを製造法(1)) と同龢に変広させることにより製造される。 更に、本製造法における化合物 (XV) は、化合物 (VII)) と4 級アンモニウム化剤とを製造法(1) の化合物 ((X) の4 級アンモニウム化皮のと同様の反応を制力を保合物 (1) は、例えば特開限53-21188テテトラヘドロンレタース、26巻、3787頁(1985年)に配載の方法法たはそれに関する方法によって製造した化合物を原料として、またUS4123528やヘテロサイクルズ。7巻、839頁(1977年)に配載の方法またはそれに準する方法によって製造した式(XI XI

[化39]

(式中の記号は前記と同意義を示す。) で表される3-メチルオキサセフェムあるいは式(XX) 『化401

R11ME CH₃ [XX]

(式中の配号は前配と同意機を示す。)で表される3-メチルカルパセフェムを、特開限55-154978に 配載の方法またはそれに厚する方法によって製造した化合物を原料として、製造法(1)~(3)に厚いて製造される。前配した製造法(1)~(3)の反応のうち、必要であれば保護基の除去および精製を行うことにより本発明の目的化合物(1)を得ることができる。以下に保護基の除去方法および精製技について説明する。

【0044】保護基除去法:前記した通りβ-ラクタム およびペプチド合成の分野ではアミノ基の保護基は充分 に研究されていてその保護法及び脱保護法はすでに確立 されている。本発明においても保護基の除去は従来の技 術をそのまま利用できる。たとえばモノハロゲノアセチ ル基 (例、クロロアセチル、プロモアセチルなど) はチ オ尿素により、アルコキシカルポニル基(例、メトキシ カルポニル, エトキシカルポニル, tert - プトキシカル ポニルなど) は酸 (例、塩酸など) により、アラルキル オキシカルポニル基(例、ペンジルオキシカルポニル、 p-メチルベンジルオキシカルポニル、p-ニトロベン ジルオキシカルボニルなど) は接触表元により、2.2. 2-トリクロロエトキシカルポニルは亜鉛と隣(例、酢 酸など) により除去することができる。一方、合成中間 体として化合物〔I〕がエステル化されている場合もそ れ自体公知の方法またはぞれに準ずる方法によってエス テル残棄を除去することができる。たとえば2-メチル スルホニルエチルエステルはアルカリにより、アラルキ ルエステル (例、ペンジルエステル、ペンズヒトリルエ ステル, p-メトキシベンジルエステル, p-ニトロベ ンジルエステルなど) は酸 (例、トリフルオロ酢酸な ど) または接触週元により、2,2,2-トリクロロエチ 50 ルエステルは亜鉛と酸(例、酢酸など)により、シリル

エステル(例、トリメチルシリルエステル、tertープチ ルジメチルシリルエステルなど) は水のみにより除去す ることができる。S-オキシドの重元は、8-ラクタム の分野で確立されている方法が用いられ、本発明におい ても従来の技術をそのまま利用できる。たとえば、三塩 化リン、三臭化リンが用いられる。

化合物 [I] の精製法:製造法(1)~(3)に詳記した各 種製造法により、また必要であれば前記の保護基除去法 をつづいて行うことにより反応離合物中に生成した化合 物 (1) は抽出法、カラムクロマトグラフィー、沈澱 10 法、再結晶法などの公知の処理手段によって単體精製す ることができる。一方、巣離された化合物 [1] を公知 の方法により所望の生理学的に登審される塩へと変換す ることもできる.

【0045】本発明の化合物 [1] はスペクトルの広い 抗菌活性を有し、毒性が低く、人および哺乳動物(例、 マウス、ラット、ウサギ、犬、ネコ、牛、豚等) におけ る病原性細菌により生する種々の疾病。たとえば気道感 染、尿路感染の予防ならびに治療のため安全に使用され うる。抗菌性化合物:[1] の抗菌スペクトルの特徴とし てつぎのような点が挙げられる。

- (1) 多種のグラム職性職に対して非常に高い活性を示
- (2) グラム陽性菌 (たとえばスタフィロコッカス・アウ レウス、コリネバクテリウム・シフテリア工等) に対し て高い活性を有している。
- (3) メチシリン耐性プドウ糠蘭 (MRSA) に対して高 い活性を有している。

(4) 多くのβーラクタマーゼ生産性グラム陰性菌(たと えばエシェリヒア県、エンテロバクター属。セラチア属。 プロテウス属等)に対しても高い簡性を有心でいる。

また本発明の抗菌性化合物 [1] は、(1) 優れた安定性を 有する、(2)血中濃度が高い、(3)効果の持続時間が長 い、(4)組織移行性が顕著であるなどの特徴をも有して いる。

【0046】本発明の化合物:(I) は公知のペニシリン 剤、セフアロスポリン剤と同様に注射剤。カブセル剤、 錠剤、顆粒剤(特に注射剤が好楽しい)として非経口ま たは経口的に投与できる。投与量は前配したような病原 性網膜に感染した人および動物の体験:1 城あたり化合物 40 (1) として0.5~80個/日、より好ましくは2~4 0 略/日を1日2~3回に分割して投与すればよい。注 射剤として用いられる場合の担体は、たとえば蒸留水、 生理食塩水などが用いられ、カブセル剤、粉剤、顆粒 剤、錠剤として用いられる場合は、公知の繁理学的に許 容される賦形剤(たとえばデンプン)乳糖、白糖、炭酸 カルシウム、リン酸カルシウム等)、結合剤(たとえば **デンプン,アラビアゴム,カルポキシメチルセルロー** ス、ヒドロキシプロピルセルロース、締島セルロース 等), 情沢剤 (たよえばステアリン酸マグネシウム. タ 50 MF, 6ml)の混合物にジイソプロピルアミン(209 ul)を加

ルク等)、破壊剤(たとえばカルポキシメチルカルシウ ム、タルク等)と混合して用いられる。なお、本願明細 書において用いられている医薬組成物および抗菌組成物 は、化合物 (1) の単独であってもよく、上記したよう な担体などが含まれていてもよく、その他抗菌性化合物 等が適宜、避量含まれていてもよい。

100471

【発明の疾痛の形態】本発明はさらに下配の参考例。実 施例、試験例で群しく説明されるが、これらの例は単な る実例であって本発明を限定するものではなく、また本 発明の範囲を逸脱しない範囲で変化させてもよい。参考 例、実施例のカラムクロマトグラフィーにおける溶出は TLC (Thin Layer Chromatography, 等層クロマト グラフィー) による観察下に行なわれた。TLC観察に おいては、TLCプレートとしてメルク (Merck) 社製 の60F254を、展開溶媒としてはカラムクロマトグラ フィーで溶出溶媒として用いられた溶媒を、検出法とし TUV検出器を採用した。カラム用シリカゲルは同じく メルク社製のキーゼルゲル60(70~230メッシ ュ)を用いた。"セファデックス"はファルマシア・フ ァイン・ケミカルズ社 (Pharmacia Fine Chemical s) 製である。XAD-2樹脂はローム・アンド・ハー ス社製 (Rohm & Haas Co.) 製である。ダイアイオ ンHP20 は三菱化成製である。NMRスペクトルは内 部または外部基準としてテトラメチルシランを用いてG emini 200型スペクトロメーターで測定し、全δ値を ppm で示した。混合溶媒において () 内に示した数 値は各溶媒の容量混合比である。また溶液における%は 溶液10.0 ml中のg数を表わす。また参考例,実施例中 の記号は次のような意味である。

: シングレット(singlet)

: ダブレット(doublet)

: トリプレット(triplet)

: クワルテット(quartet)

ABa : AB型クワルテット(AB type quartet)

: ダブル ダブレット(double doublet)

: マルチプレット(multiplet)

: プロード シングレット(broad singlet)

: カップリング定数(coupling constant)

[0048] 【実施例】

参考例 1

78-tert-プトキシカルポニルアミノ-3-[(E)-2-(5-メチ ルチアソロ[4,5-c]ピリジニウム-2-イル)チオエテニル] -3-セフェム-4+カルポキシレート ヨージド

ジフェニルメチル 7β-tert-プトキシカルポニルアミノ -3-[(E)-2-(トシルオキシ)エテニル]-3-セフェム-4-カ ルポキシレート 1-オキシド(679mg)、2-メルカプトチア ゾロ[4,5-c]ピリジン(216mg)、ジメチルホルムアミド(D え、60℃で1時間提幹した。酢酸エチル(100ml)を加え 水、飽和食糧水で携帯後、乾燥(編SO₄)した。溶線を留 去し残留明をシリカゲルクロマトグラフィーに付し、酢 豫エチルで審出しジフェニルメチル7.8-ter4-プトキシ カルポニルアミノ-3-[(E)-2-(チザゾロ[4.5-]ピリジン-2-イル)チオエチゴル]-3-セフェム-4-カルポキシレート 1-オキシドを抽状物として得た(216mg, 32.0%)。NMR (CDCla): 1.49(9H; s), 3.38(1H, d. J=18.2Hz), 4.24 (1H. d. J=18.2Hz), 4.58(1H. d. J=4.8Hz), 5.71-5.89 (2H, m), 7.00(1H, s), 7.21-7.52(11H, m), 7.63(1H, d, J=15.8Hz), 7.75(1H, d, J=5.6Hz), 8.49(1H, d, J=5.

35

6Hz), 9.20(1H, s). この油状物のDMF(1.5ml)溶液を-70℃に冷却し、三塩化 リン(86.5±1)を加え10分階撹拌した後、重曹水-酢酸エ チル(1:1, 20ml)中に加えた。有機瘤を分取し水洗後乾 燥(MgSO4)した。漆鏃を留去し残留物をシリカゲルクロ マトグラフィーに付しヘキサン-酢酸エチル(1:1)で薬 出し、ジフェエルメチル 78-tert-ブトキシカルポニル アミノ-3-「(E)-2-(チアソロ[4.5-]ピリジン-2-イル)チ オエテニル]-3-セフェム-4-カルポキシレートを抽状物 として得た(182mg, 83.9%)。NMR(CDC1s): 1.48(9H. s), 3.69(1H, d, J=17.6Hz), 3.82(1H, d, J=17.6Hz), 5.05(1H, d, J=4.8Hz), 5.29(1H, d, J=9.0Hz), 5.69(1 H. dd. J=4.8. 9.0Hz), 7.00(1H.s), 7.20-7.49(12H. n), 7.75(1H, d. J=5.6Hz), 8.48(EH, d, J=5.6Hz). 9. 20(1H. s).

本油状物をアセトン(12ml)、テドラヒドロフラン(THF, 4ml)に溶解しヨー化メチル(372 ml)を加え、室温で18時 間撹拌した。滞業を留虫し残留物にエーテルを加えジフ ェニルメチル 78-tert-フトキョカルポニルアミノ-3-[(E)-2-(5-メチルチアゾロ[4,5-c]ピリジニウム-2-イ ル)チオエテニル]-3-セフェム-4-カルポキシレート ヨ ージドを結晶として得た(174mg, 78.7%)。NMR(DMSOd.): 1.43(9H, s), 3.75(1H, d, J=18.0Hz), 4.10(1H, d, J=18.0Hz), 4.44(3H, s), 5.24(1H, d, J=5.0Hz), 5,651H, dd, J=5.0, 8.2Hz), 7.00(1H, s), 7.17-7.49 (12H, m), 8.13(1H, d, J=8.2Hz), 8.74(1H, d, J=7.2H z), 8.80(1H, d, J=7.2Hz), 9.74(1H, s).

[0049] 参考例 2

ジフェニルメチル 7β-tert-プトキシカルポニルアミノ -3-{(E)-2-(1-メチルセリジニウム-4-イルチアソール-2 -イル)チオエテニル]-3-セフェム-4-カルポキシレート ヨージド

ジフェニルメチル 7β-tert-プトキシカルポエルアミノ -3-[(E)-2-(トシルオキシ)エテニル]-3-セフェム-4-カ ルポキシレート 1-オキシド(1.7g); 4-(4-ピリジル)-2-メルカプトチアゾール(582mg)、シメチルホルムアミド (15ml)の混合物に氷冷下トリエチルアミン(0.42ml)を摘 下した。室温で8時間撹拌した後、重響水中に加え酢酸 エチルで抽出した。抽出液は水洗乾燥(MgSO₄)後、溶媒 50 ポキシレート(1.0g)、ジメチルホルムアミド(15ml)の混

を留去し残留物をジメチルホルムアミド(10ml)に溶解し た。ついで-40℃で3塩化リン(0.65ml)を積不し、20分間 -40℃で撹拌し重要水中に加えた。酢酸エチルで抽出し 水洗乾燥(MgSO₄)後、溶媒を留去しシリカゲルクロマト **グラフィーに付し酢酸エチルで輸出して、ジフェニルメ** チル 7.8-tert-プトキシカルポニルアミノ-3-[(E)-2-(4 - (4-ピリジル)チアゾール-2-イル)チオエテニル1-8-セ フェム-4-カルポキシレートを簡単として得た(807歳, 4 7%), NMR(CDC1:): 1.48(9H, s), 3.68(1H, d. J=17.2H 10 z), 3.72(1H, d, J=17.2Hz), 5.04(1H, d, J=4.8Hz). 5, 27 (1H, d, J=9, 2Hz), 5, 68 (1H, dd, J=4, 8, 9, 2Hz). 6 99(1H. s) 7.11(1H. d. J=16Hx), 7.30-7.47(11H. m), 7.66(1H, s), 7.76(2H, d, F=8.2Hz), 8.69(2H, d, I=6, 2Hz)

。ジフェニルメチル 7β-tert-プトキシカルポニルアミ ノ-3-[(E)-2-(4-(4-ピリジル)チアゾール-2-イル)チオ エテニル]-3-セフェム-4-カルポキシレート(137mg)、ヨ ー化メチル(0,25ml)、テトラヒドロフラン-アセトン (1:3. 2m1)の混合物を電温で16時間提拌した。溶媒を 留去し残留物にイソプロピルエーテルを加え、ジフェニ ルメチル 78-tert-プトキシカルポニルアミノ-3-[(E)-2-(4-(1-メチルビリジニウム-4-イル)チアゾール-2-イ ル)チオエテニル1-3-セフェム-4-カルポキシレート ヨ ージドを粉末として定量的に得た。MAR(DMSO-ds): 1.42 (9H, s), 3.73(1H, d, J=17.6Hs), 4.07(1H, d, J=17.6H z), 4,32(3H, s), 5,21(1H, d, J=4.89x), 5,61(1H, d d, J=4.8, 9.0Hz), 6.95(1H, s), 7.11(1H, d, J=15.8H z) 7 24-7 49 (11H, m), 8 11 (1H, d, J=9 0Hz). 8 57 (2 H, d, J=7.0Hz), 8.98(1H, s), 9.00(2H, d, J=7.0Hz).

【0050】参考例 3 78-アミノ-3-[4-(1-メチルピリジニウム-4-イル)チア ソール-2-イル]チオ-3-セフェム-4-カルポキシレート 4-(4-ピリジル)-2-メルカプトチアゾール(388mx)とテト ラヒドロフラン(10ml)の混合物にNaH(60%オイル含有、 80mg) を加え、家温で20分間撹拌した。~15℃に冷却下、 p-メトキシベンジル 7-フェニルアセトアミド-3-トリフ ルオロメタンスルホニルオキシ-3-セフェム-4-カルボキ シレート(1,06g)を加え-15℃で30分間撹拌した。水を加 え得られた結晶をろ取し、水、冷却したアセトンで洗浄 しp-メトキシベンジル 7-フェニルアセトアミド-3-[4-(4-ヒリジル)チアゾール-2-イル]チオ-8-セフェム-4-カ ルポキシレートを得た(1.10g. 87.3%)。 NMR(DMS0da) : 3,46-3,69(3H, m), 3,70(3H, s), 3,94(1H, d, J= 17.8Hz), 5.23(2H, s), 5.28(1H, d), 5.82(1H, dd, J= 5. 0. 8. OHz), 6. 84(2H, d, J=8. 4Hz), 7. 22-7. 30(7H, m), 7.89(2H, d. J=6.0Hz), 8.52(1H, s), 8.66(2H, d. J=6.0Hz), 9.27(1H, d, J=8.4Hz). p-メトキシベンジル 7-フェニルアセトアミド-3-[4-(4-

ピリジル)チアソール-2-イル]チオ-3-セフェム-4-カル

37 合物にヨー化メチル(2,0m1)を加え、高雄で2時間接針した。 淳集を留本し残留物にエーテルを加え、ロメトキシベンジル ?-フェニルアセトアミド-3-16・(1・メチルビリジニウム-4-イル)チアソール-2-ゴル)チオペラ・セフェム-4-カルボキシレート、ヨージドを誘姦として得た(1・28・

95%).

五塩化リン(936mg)とジクロロメタン(6m1)の混合物に氷 冷下ビリジン(0.364回) 春繭下し、水冷下で)時間提押し た。 ついでローメトキシベンジル 7-フェニルアセトアミ ド-3-【4-(1-メチルビリジニウム-4-イル)チアソール-2-イル]チオ-3-セフェム-4-カルボキシレート ヨージド (1.16g)を加え、さら近1時間撹拌した後、-30℃に冷却し メタノール(2.0ml) 密調面した。1時間-10年で撹拌した 後エーテルを加え、上澄みを除いた。残留物をジクロロ メタン(6ml)、アニソール(Q.5ml)に溶解し、トリフルオ 口静酸(3ai)を氷冷下に加え、脂温で1時間機体後、溶媒 を留去した。残留物にエーテルを加え沈殿をろ取し、重 曹水に鎔解しダイアイオン HP-20クロマトグラフィ-に 付し20%エタノール可溶出し機構、液結乾燥して7.8-ア ミノ-3-[4-(1-メチルヒリジニウム-4-イル)チアソール- 20 2-イル]チオ-3-セフェム+4-カルポキシレートを粉末と して得た(427mg, 70%)。NMR(D:0): 3.48(1H, d, J=17. 6Hz), 3.87(1H, d. J=17,6Hs), 4.80(3H, s), 4.79(1H. d, J=5.2Hz), 5.16(1H; d, J=5.2Hz), 8 27(2H, d, J= 7. OHz), 8. 44(1H, s), 8, 69(2H, d, J=7. OHs).

【0 0 5 1 】 参考機 4 参考側 1 と同様にしてジフェニルメチル・7 8 - 1 ert・ブトキシカルボニルアミノ・3・1 (億)・2・(ア・メチルチアソロ[5, 4-1) はリジニウム・2・イル)デオエチニルコ・3・センエム・4 - カルボキシレート ヨージドを製造した。NNR (DMSO - 30 d.): 1、42(8), 3)、3,76(16, d., 1-17.6 m²)、4.50(3 H., s.)、5, 23(1 H. d.) = 5, 4 Hz)、5, 65(1 H. d., 1 - 5, 4 Hz)、8, 8, 96(1 H. d.) = 7, 6 Hz)、9, 97(1 H. d.) = 5, 8 Hz) = 5, 9 Hz) = 5,

[0052] 移考例:5

参考例 3と同様にして以下の化合物を製造した。

7β-アミソ-3-[4-(1+(2-チアゾリルメチル)ピリジニウ ム-4-イル)チアゾナル-2-イル]チオ-3-セフェム-4-カル ポキシレート 塩産塩

NMR(D₁O): 3. 54(1H, d, J=17.6Hz), 3. 98(1H, d, J=17.6Hz), 5. 19(1H, d, J=5.0Hz), 5. 40(1H; d, J=5.0Hz), 6. 15(2H, s), 7. 73(1H; d, J=3.2Hz), 7. 85(1H, d, J=3.2Hz), 8. 41(2H, d, J=7.0Hz), 8. 59(1H, s), 8. 93(2H, d, J=7.0Hz).

7 B-アミノ-3-(5-メチルチアソロ[4,5-c]ヒリジニウム-2-イル)チオ-3-セフェム-4-カルポキシレート

7 B - アミノ-3-[4-(1-メチルビリジニウム-3-イル)チア ゾール-2-イル)チオ-3-セフェム-4-カルボキンレート NGR(D₂D): 3.50(1B, d, J=17.4Bz), 3.88(1B, d, J=17. 4Bz), 4.42(3B, s), 4.85(1B, d, J=5.2Bz), 5.18(1B, d, J=5.2Bz), 8.05(1B, dd, 6.2, 8.0Bz), 8.15(1B, s), 8.71(1B, d, J=6.2Bz), 8.81(1B, d, J=8.9Bz), 9. 21(1B, s).

78-アミノ-3-[4-(1-メチルビリジニウム-2-イル)チア ソール-2-イル]チオ-3-セフェム-4-カルポキシレート

NUR(DMSO-Da): 3.50(1H, d, J=17.6Hz), 3.84(1H, d, J=17.6Hz), 4.40(3H, s), 4.66(1H, d, J=5.4Hz), 4.99(1H, d, J=5.4Hz), 8.36(1H, m), 8.36(1H, m), 8.51(1H, s), 8.62(1H, m), 9.08(1H, m)

78-7ミノ-3-[5-メチル-4-(1-メチルビリジニウム-4-イル)チアソール-2-イル]チオ-3-セフェム-4-カルポキ シレート

NMR(DaO): 2.61(3H, s), 3.43(1H, d, J=17.4Hz), 3.80 (1H, d, J=17.4Hz), 4.30(3H, s), 4.78(1H, d, J=5.2H z), 5.12(1H, d, J=5.2Hz), 8.14(1H, d, J=6.4Hz), 8. 69(1H, d, J=6.4Hz).

[0053] 参考例 6

3-(4-ピリジル)チオフェン

4・ビリジンボロン酸(1.23g), 3・プロモチオフェン(1.63 g), テトラキス(トリフェニルホスフィン)バラジウム (6)(0,58g), 2世 炭酸ナトリフ本茶酸(801), トルエン (20ml), エタノール(5ml)の混合物を5時間、窒素気液下 辺輪(MaSO) した。溶解を毎日、光電粉をシリカゲル クロマトグラフィーに付し、ヘキサン・静隆エチル(2: 1)で附出し表眼化合物を停た(0.8g, 49.7%)。NR(CDC1): 7.45(2H, d, J=2.28g), 7.49(2H, d, J=6.281), 7. 66(1H, t, J=2.28g), 8.62(2H, d, J=6.281).

2-(2,4-ジニトロフェニルチオ)-4-(4-ピリジル)チオフ

エン
3-(4-ピリジル) チオフェン(0.8g), 2.4-ジニトロフェニ
ルスルフェニルクロリド(1.29g), ニトロエタン(15ml)
の混合物に、塩化アルミニウム(1.33g)を加え、蒸暖でき
時間接伸した。 H. 0を加え、炭酸水東ナリウム水形成
で中和し、不溶物をろ去し肝障エチルで輸出した。 抽出
被は、水洗乾燥(編S0.0) し溶媒を留ました。残留物をシリ
カゲルクロマドグラフィーに付し、ヘキサン・酢酸エチ
ル(1:1) で添加し、表題化合物を得た(0.85g、47.8%)。
NMR(CDCl) : 7,25(1H, d, J=,2Hz), 7.51(2H, d, J=6.2Hz), 7.77(1H, d, J=1.6Hz), 8.02(1H, d, J=1.6Hz), 8.26(1H, dd, J=2.6, 9.2Hz), 8.70(2H, d, J=6.2Hz), 9.13(1H, d, J=2.6; 9.2Hz), 8.70(2H, d, J=6.2Hz)

【0054】参考例 8

7β-アミノ-3-[4-(1-メチルビリジニウム-4-イル)チオ 50 フェン-2-イル]チオ-3-セフェム-4-カルポキシレート

参考例 9

78-アミノ+3-[4-(1-メチルビリジエウム-3-イル)チオフェン-2-イル)テオラ・セフェム・4-カルボキシレート、参考例 6、7、8と同様の方法によって、表題化合物を特た、NRC(0.0): 3,29(1H, d, J=17-6Hz), 3,53(1H, d, J=17-6Hz), 4,36(3H, s), 4,65(1H, d, J=4,0Hz), 4,98(1H, d, J=4,0Hz), 7,51(1H, d, J=1,4Hz), 8,00(JH, a), 8,02(JH, d, J=1,4Hz), 8,58(2H, a), 9,01(JH, s), [0,0.5] 参考例 10

5-アセチル-4, 5, 6, 7-テトラヒドロチエノ[3, 2-c]ピリジ

2-(2-チエニル)エチルアミン(496,09)に無水酢酸(42.0g 1)を-15℃で高下した。-15℃で39分前さらに幸温で30分間操作した後、熔媒を留立した。発露物をトルエン(300 ml)に溶解し、パラホルムアルデビド(7.36g)、ロールルエンスルホン酸水和物(1.94g)を加減し、Dean-Stark 水物分配機を付し、40分類和外離度した。投資水来ナトリウム水溶液、水で爆水洗浄後、販機(基料50.4)し、溶媒を留去した。投資物を分均カゲルクロマトグラフィーに付し、ヘキサン-アセドン(42.1)で溶出し、表題化合物を得た(24.0g, 65%)。NBK(たけ.1):2,118(1.18,13)、2,20(1.5 H, s)、2,52(18,1,15;5,80g.)、4,55(18,s)、4,67(1

総套例 11

5-アセチル-4, 5, 6, 7-テトラヒドロ-2-(2, 4-ジニトロフェニルチオ)チエノ[3, 2-c]ピリジン

5-アセチル-4,5,6,7-テトラヒドロチエノ[3,2-c] レリジン(23,8g)、2,4-ジェトロフェエルスルフェニルクロリド(32,3g)、ニトロエタン(40mg)の風合物に、水冷下、塩化アルミニウム(21,0g)を納々に加えた。水冷下に30分間、窓温で1時間選件し、米煮中に加え酢酸エチルで指出した。抽出硫は水素乾燥(40%0)、後、溶媒を留ました圏化合物を結晶として得た」。5.3kを(47,70g)・94%)、別線(CDQ1s):2,2(1,51,5)、2,2(4,158,5)、2,92-3,90(28, p)・3,83(1H,1,15,81)、4,60(1H,5)、4,73(1H,5),7,15-7,29(21)

40 m),8.22-8.29(1H, m), 9.10(0.5H, s), 9.11(0.5H, s)。 【0.056】参考例 12

4, 5, 6, 7-テトラヒドロ-2-(2, 4-ジニトロフェニルチオ) チエノ[3, 2-c] ピリジン

テエアは、2-61 (27-2) (27-

参考例 13

参考例 15

2+(2,4-ジニトロフェニルチオ)チエノ[3,2-c]ピリジン 4,5;6,7-テトラヒドロ-2-(2,4-ジニトロフェニルチオ) チエノ[3,2-c]ピリジン(9,33g)、二酸化マンガン(50g)、

- ジメトキシエタン(130ml)、トルエン(180ml)の混合物を 2時間加熱週流した。二酸化マンガンを留去し、ろ液を 濃縮し得られた結晶をろ取し、エーテルで洗浄し表題化 合物を得た(6.62g、65%)。NMR(CDC1s):7, 28(1 d, J = 9.0 Hz), 7.82-7.86 (1 H. m). 7.88(1H. d. J = 1.8. 25 (1H, dd. J = 2.6.0 Hz), 9.0Hz), 8.61(1H, d. 9. 15 (1H. J = 2.6 HHz). d. 9. 22 (1H, d. J = 1: 0 Hz). 【0057】参考例 14
 - カリウム チエノ(3,2-c]ピリジン-2-チオラート 水酸化カリウム (317mg)のパタノール(25ml)溶液に、2-(2,4-ジニトロフェニルチオ)チエノ(3,2-c]ピリジン(1, 38g)を加え、0.5時間加熱圏域した。溶媒を留去し得ら れた結晶をろ取し、エーデルで洗浄して、表題化合物を 定量的に得た、NMR(CD・0D): 6.85(1H, s),7.5(1H, d. 1-5.082),7.97(1H, d. 1-5.082),8.45(1H, s),

2-(2,4-ジニトロフェニルチオ)チエノ[2,3-c]ピリジン

善例 10, 11, 12, 13に配慮の方法に従って、2~G-デ エニル)エチルアミンから表際化合物を製造した。NMR(C DCi3):7.27(1H, d. J=9,0Hz), 7.78(1H, d. J=5,6Hz), 7.80(1H, s), 8.25(1H, dd. J=2,2,9,0Hz), 8.64(1H, dj. J=5,6Hz), 9.15(1H, d. J=2,6Hz), 9.21(1H, s), [0 0 5 8] 参考例 16

10058] 参考例 16 カリウム チエノ[2,3-c]ピリジン-2-チオラート

対 50 月 1 1 4 と同様にして2-(2,4・ジュトロフェニルチオ) チェグ [2,3-c] ピリジンから表題化合物を製造した。NMR (DMSO-ds): 6.33(1H, s). 6.98(1H, d, J=5.6Hz). 7.93 (1H, d, J=5.6Hz). 8.32(1H, s).

参考例 17 78-アミノ-3-(5-メチルチエノ[3,2-c]ピリジニウム-2-イル)テオ-3-セフェム-4-カルボキンレート 参考例 14で得たカリウム チエン[3,2-c]ピリジン-2-チ オラートを用いて、参考例 3上間様の方法によって、表 銀化合動を様た、内臓(DMSO-4m): 3,20(18, d, J=17,00 3),3;70(18, d, j=17,00k): 4,37(3H, s), 4,65(1H, d, J=5,2Mz), 4,96(1H, d, J=5,2Mz);77(3(1Mz)-3), 8, 62(2M, s), 9;41(1H, s).

41

78-アミノ-3-(6-メチルチエン[2,3-c]とリンユウム-2-イル)チオ-3-セフェム4-カルボボランレート 参考例 16で報たカリウム チェン[2,3-c]とリジン-2-デ オラートを用いて、参考例 3と同様の方法によって、表 既化合物を得た、DR(DMSD/dd): 3,25(1g, d, 1-17, 0R J, 3,81(1d, d, 1-17, 0R), 4,31(3R, 3), 4,69(1H, d, 1-5,2R;), 5,02(1H, d, 1-5,2Hz), 7,59(1H, s), 8, 11(2H, d, 1-6,0Hz), 8,57(3H, d, 1-6,0Hz), 9,52(3H, s),

【0059】参考例 19 78-アミノ-3-【は)-2-(6-メデルチエノ{3,2-c}はリジニ ウム-2-イル}チオエテニル]-3-セフェム-4-カルポキシ レート ジトリフルオロアセチート

カリウム チエノ[3,2-c]ピリジン-2-チオラート(1.17g) を、0℃に冷却したジフェニルメチル 7β-tert-プトキ シカルポニルアミノ-3-{(E)-2-(トシルオキシ)エテニ ル]-3-セフェム-4-カルポキシレート 1-オキシド(2.46 g) のジメチルホルムアミド(20m1) 捜液に少しづつ加え た。0℃で30分間撹拌した後、酵酸エチルで希釈し、水 洗乾燥(MgSO4)後、密媒を留去した。残留物をジメチル ホルムアミド(18ml) 比擦解し、-40℃に滑脚下主塩化リ ン(0.96m1)を満下した。-40℃で15分間機件し水水中に 加え、酢酸エチルで抽出した。抽出被は歳酸水康ナトリ ウム水溶液、水で順次洗浄機、乾燥(mgS0a)した。溶媒 を留法し残留物をシリカゲルクロマトグラフィーに付 し、ヘキサン-酢酸エチル(1:4)で推出し、ジフェニル メチル 7β-tert-プトキシカルポニルアミノ-3-[(E)-2-(チエノ[3,2-c]ピリジン-2-イル)チオエテニル]-3-セフ ェム-4-カルポキシレートを得た(1.27g)。本品をジメチ ルホルムアミド(8ml)に溶解し、エー化メチル(2ml)を加 え、富温で3時間撹拌した。際線を留去し残留物にイソ プロピルエーデルを加え、まく抜粋した後、イソプロピ ルエーテルを除いた。 残留物をジクロロメタン(10ml)、 アニソール(2ml)に溶解し、氷冷化にトリフルオロ酢酸 (10ml)を加えた。室温で2時間撞鉾した後、溶菓を留去 しエーテルを加え沈徹をお歌し、接頭化合物を得た。NM d. 0=18.0H R(DNSO-de): 3. 66 (1H. z), 3, 97 (1H, d, J=18, 0H s), 4.93 (1H. 4. 41 (3H) z). 5. 11 (IH. d. d. J = 5. 2 H z):

J=5. 2Hz), 7. 16 (2H, s), 8. 03 (1H, s), 8. 71 (2H, s), 9. 47 (1H, s).

[0060] 参考例 20

7 B-アミノ-3-[4-(1-カルバモイルメチルビリジニウム -4-イル)チアゾール-2-イル]チオ-3-セフェム-4-カルボ キセレート

五塩化リン(1.25g)のジクロロメタン(10ml)溶液に、氷 帝下ピリジン(0.45ml)を加えた。氷冷下に30分間撹拌し た後、参考例 3で得たp-メトキシベンジル 78-フェニ 10 ルアセトアミド-3-[4-(4-ピリジル)チアゾール-2-イル] チオ-3-セフェム-4-カルポキシレート(1.4g)を加えた。 氷冷下に1時間撹拌し、ついで-30℃に冷却下、メタノー ル(2ml)を着下した。0℃で30分間撹拌し、エーテル(50m 1)を加え上澄みを除いた。残留物に炭酸水素ナトリウム 水溶液を加え、酢酸エチルで抽出した。抽出液は水洗乾 ■(MgSO₄)後、溶媒を留去し、テトラヒドロフラン(10m l)に溶解した。二炭酸ジ-tert-プチル(0.83g)を加え、 密揚で2時間撹拌した後、酢酸エチルを加え、水洗乾燥 (MgSO4)後、溶媒を留去した。残留物をシリカゲルクロ マトグラフィーに付し、ヘキサン-アセトン(1:1)で溶 出し n-メトキシベンジル 7β-tert-ブトキシカルポニ ルアミノ-3-[4-(4-ピリジル)チアゾール-2-イル]チオ-3 -セフェム-4-カルボキシレートを得た。本品をジメチル ホルムアミド(6ml)に密解し、ヨー化アセトアミド(1.8 g)を加え、重塩で45時間撹拌しエーテルを加え、沈殿を ろ取しp-メトキシペンジル 7β-tert-プトキシカルポニ ルアミノ-3-{4-(1-カルバモイルメチルピリジニウム-4-イル)チアゾール-2-イル]チオ-3-セフェム-4-カルポキ シレート ヨージドを得た(0.6g)。本品をジクロロメタ ン(5ml)、アニソール(0.5ml)に溶解し、氷冷下トリフル オロ酢酸(5ml)を加え、室温で40分間撹拌した。エーテ ルを加え栃出した粉末をろ取し、表題化合物を得た(0.4 g, 95.2%), NMR (DMSO-do): 3.75(1H, d, J=16.6Hz), 3.99(1H, d, J=16.6Hz), 5.24(1H, d, J=6.0Hz), 5.36 (1H, d, J=6.0Hz), 5.39(2H, s), 7.73(1H, s), 8.08(1 H. s), 8.61(2H, d. J=6.0Hz), 8.98(2H, d. J=6.0Hz), 9.11(1H, s).

【0061】実施例1

7β-[2-(5-アミノ-1,2,4-チアジアゾール-3-イル)-2(2)
-メトキシイミノアセトアミド]-8-[(2)-2-(5-メチルチ アゾロ[4,5-c]ピリジニウム-2-イル)チオエテニル]-3-セフェム-4 カルポキシレート

ジフェニルメチル 7 g-tert-ブトキシカルボニルアミノ
-3-[(E)-2-(5-メチルチアゾロ[4,5-c] ピリジニウム-2イル) チオエテニル]-3・セフェム・4-カルボキシレート
ヨーダイド(86mg)、ジクロロメタン(0.7ml)、アニソー
ル(100 u)の混合物にトリフルオロ酢酸(0.7ml)を加え。
産温で1時間接件した。溶媒を留去し、残留物に飽和重
50 曹水(1.0ml)、TMF(1.0ml)を加え、水冷下提弁しながら、

2-(5-アミノ-1, 2, 4-チアジアゾール-3-イル)-2(2)-メ トキシイミノアチルクロリド·塩酸塩(55mg)を加えた。1 0分後IRFを留去し発信物をダイアイオンHP-20カラムク ロマトグラフィーに付し20%エタノールで輸出し、後 格、機能乾燥し表態化合物を得た(25mg. 39.6%)。 IR (RRe) enr 1 : 3400 1770 1870 1603 MRR (DMSOd.) : 3.54(1H. d. J=17.0Hz), 3.68(1H. d. J=17.0Hz), 3. 93(3H, s), 4. 41(3H, s), 5. 13(1H, d, J=5.0Hs). 5. 6B(1H, dd, J=5.0. 8. 2Hz); 6. 65(1H, d, J=15. 2Ha). 7. 68(1H, d, J=15. 2Hz); 8. 16(2H, s), 8. 71(1H, d, J 10 =6.6Hz), 8.76(1H, d, J=6.6Hz), 9.58(1H,d, J=8.2H z). 9.70(1H. a).

事施例 2

事業例 1と同様にして以下の化合物を製造した。

78+[2-(5-アミノ-1,2,4-チアジアゾール-3-イル)-2(2) -フルオロメトキシイミノアセトアミド]-3-[(B)-2-(5-メチルチアソロ[4,6-c]ピリジニウム-2-イル)チオエテ ニル]-3-セフェム-4-カルポキシレート

IR(KBr) cm 1 : 3425, 1770, 1670, 1610, NMR(DMS0d.): 3.55(1H, d, J=16.8Hz), 3.67(1H, d, J=16.8Hz), 4.41(3H; s), 5.14(1H, d, J=5.0Hz), 5.67(1H, dd, J= 5.0. 7.8Hz). 5.81(2H. d. J=54:2Hz), 6.64(1H. d. J= 15.4Hz), 7.70(1H, d, J=15.4Hz), 8.23(2H, s), 8.70 (1H. d. J=6.6Hs), 8.76(1H, d. J=6.6Hz), 9.68(1H, s), 9,76(1H, d, J=7.8Hz).

[0062] 実施例 3

実施例 1と同様にして以下の化合物を製造した。

78-[2-(5-アミノ-1, 2, 4-チアジアゾール-3-イル)-2(1) -エトキシイミノアセトアミド]-3+[(E)-2-(5-メチルチ アソロ[4,5-c]ヒリジニウム-2-イル)チオエテニル]-3- 30 セフェム-4-カルポキシレート

IR (KBr) cm-1: 3400, 1762, 1670, 1605, NMR (DMS0de); 1.29(3H, t, 7.0Hz), 3.58(1H, d, 16.8Hz), 3.75 (1H. d. J=16.8Hz), 4.21(2H; q, J=7.0Hz), 4.43(3H; s), 5.17(1H, d, J=5.2Hz), 7.75(1H, dd, J=5.2. 8.0H z), 6.77(1H, du J=15.4Hz), 7.64(1H, d, J=15.4Hz), 8.17(2H, s), 8,721H, d, J=6.6Hz), 8.78(1H, d, J=6. 6Hz), 9:58(1H, d, J=8.0Hz), 9.71(1H, s).

実施例 4

実施例 1と同様にして以下の化合物を製造した。

7g-[2-(5-アミノ-1, 2, 4-チアジアゾール-3-イル)-2(2) -イソプロポキシイミノアセトアミド]-3-[(E)-2-(5-メ チルチアソロ[4,5-c]ピリジニウム-2-イル)チオエテニ ル]-3-セフェム-4-カルポキシレート

IR(KBr) cm 1 : 3400, 1762, 1670, 1602, NMR(DMS0d₆): 1.19-1.30(6H, m), 3.55(1H, d, J=16.8Hz), 3.70 (1H, d, J=16.8Hz), 4.41(1H, m); 4.42(3H, s),5.15(1 H. d. J=5.2Hz), 5.70(1H, dd, J=5.2, 8.4Hz), 6.69(1 H, d, J=15.4Hz), 7:68(1H, d, J=15.4Hz), 8.17(2H, s), 8.71(1H, d, 6.8Hz), 8.77(1H, d, J=6.8Hz), 9.53 50 z), 8.93(1H, s), 8.98(2H, d, J=6.4Hz), 9.76(1H, d,

(1H. d. J=8.4Hz), 9.70(1H, s).

【0063】 事炼例 5 実施例 1と同様にして以下の化合物を製造した。

78-[2-(5-アミノ-1, 2, 4-チアジアゾール-3-イル)-2(2) -シクロペンチルオキシイミノアセトアミド]-3-[(E)-2-(5-メチルチアゾロ[4,5-c]ピリジニウム-2-イル)チオエ テニル]-3-セフェム-4-カルポキシレート

IR(KBr) cm-1: 3400, 1762, 1662, 1602, NMR(DMS0de): 1.24-1.92(8H, m), 3.53(1H, d. J=16.8Hm). 3.66 (1H, d. J=16.8Hz), 4.41(3H, s), 4.74(1H, m), 5.13(1 H. d. J=5.0Hz), 5.64(1H. dd. J=6.0, 8.4Hz), 6.95(1 H. d. J=15.0), 7.69(1H, d. J=15.0Hz), 8.15(2H, s), 8.70(1H, d, J=6.6Hz), 8.76(1H, d, J=6.6Hz), 9.52 (1H. d. J=8.4Hz), 9.68(1H, s).

実施例 6

78-[2-(5-アミノ-1, 2, 4-チアジアゾール-3-イル)-2(2) - メトキシイミノアセトアミド7-3-「(E)-2-(4-(1-メチル ピリジニウム-4-イル)チアゾール-2-イル)チオエテニル -3-セフェム-4-カルポキシレート

ジフェニルメチル 78-tert-プトキシカルポニルアミノ -3-「(E)-2-(4-(1-メチルビリジニウム-4-イル)チアゾー ル-2-イル)チオエテニル]-3-セフェム-4-カルポキシレ ート ヨージド(130mg)、アニソール(0,25ml)、ジクロロ メタン(1.5ml)、の混合物に氷冷下トリフルオ口酢酸(1.5 al)を加え、容温で1時間機棒した。エーテルを加え沈殿 をろ取し、テトラヒドロフラン-水(1:1, 2ml)に溶解 し、重要水で pH 9に保ちながら2-(5-アミノ-1,2,4-チ アジアゾール-3-イル)-2(2)-メトキシイミノアチルクロ リド 塩酸塩(82%)を加えた。30分撹拌した後テトラヒ ドロフランを留去し、残留物をダイアイオンHP-20クロ マトグラフィーに付し、20%エタノールで熔出し濃縮、 康納乾燥して表題化合物を得た(9mg, 9%)。

IR(KBr): 1765, 1640, 1605, NMR(DMSO-da): 3.52(1R, d. J=18.4Hz), 3.62(1H, d. J=18.4Hz), 3.93(3H, s), 4.30(3H, s), 5.09(1H, d, J=5.2Hz), 5.65(1H, dd, J= 5. 2. 8. 4Hz), 6. 53(1H, d, J=15. 4Hz), 7. 57(1H, d, J= 15.4Hz), 8.14(2H, s), 8.56(2H, d, J=6.8Hz), 8.92(1 H. s). 8.97(2H. d. J=6.8Hz), 9.56(1H. d. 8.4Hz). 【0064】 実施例 7

40 実施例 6と同様にして以下の化合物を製造した。

7β-[2-(5-アミノ-1, 2, 4-チアジアゾール-3-イル)-2(1) -フルオロメトキシイミノアセトアミド]-3-[(E)-2-(4-(1-メチルピリジニウム-4-イル)チアゾール-2-イル)チ オエテニル-3-セフェム-4-カルポキシレート

IR(KBr): 1765, 1640, 1600. NMR(DMSO-d.): 3.53(1H, d. J=17Hz), 3,63(1H, d. J=17,0Hz), 4,31(3H, s), 5,1 1(1H, d, J=4.8Hz), 5.67(1H, dd, J=4.8, 8.4Hz), 5.8 0(2H, d, J=54.0Hz), 6.53(1H, d, J=15.2Hz), 7.57(1 H. d. J=15.2Hz). 8.23(2H, bs), 8.56(2H, d, J=6.4H

(C) 2000 Copyright Derwent Information Ltd.

J=8.4Hz).

事施例 8

実施例 6と再様にして以下の化合物を製造した。

78-[2-(5-アミノ-1, 2, 4-チアジアゾール-3-イル)-2(2) -エトキシイミノアセドアミド]-3-[(B)-2-(4-(1-メチル ヒリジニウム-4-イル)チアソール-2-イル)チオエテニル -3-セフェム-4-カルポキシレート

45

IR(KBr): 1765, 1640; 1600, NMR (DMSO-de): 1.27(3H, t. J=7.0Hz), 3.53(1H; d, J=18.0Hz), 3.64(1H, d, J= 18. OHz), 4. 19(2H; q, J=7. OHz); 4.31(3H; s), 5. 10(1 10 H. d. J=5.0Hz), 5.66(1H, dd. J=5.0, 8.4Hz), 6.53(1 H. d. J=15. 2Hg), 7.57 (1H, d. J=15. 2Hz), 8.16(2H, b s), 8.57(2H, d, J=7.0Ht), 8.93(1H, s), 8.98(2H, d, J=7.0Hz), 9.55(1H, d, J=8.4Hz).

[0065] 実施例 9

実施例 6と同様にして以下の化合物を製造した。

78-[2-(5-アミノ-1, 2, 4-チアジアゾール-3-イル)-2(2) -イソプロポキシイミノアセドアミド]-3-[(E)-2-(4-(1-メチルピリジニウム-4-イル)チアゾール-2-イル)チオエ テニル-3-セフェム-4-カルボキシレート

IR(KBr): 1760, 1635, 1600, NNR(DMSO-ds): 1.26(3H, d, J=6.0Hz), 1.28(3H, d. N=6.0Hz), 3.52(1H, d, J=1 7.2Hz), 3.64(1H; d, J=17.2Hz), 4.31(8H, s), 4.31-4. 48(1H. m), 5. 10(1H. d. J=5|OHz), 5. 66(1H, dd. J= 5. 0, 8. 4Hz), 6. 53(1H, d, J=15. 4Hz), 7. 56(1H, d, J= 15.4Hz), 8.16(2H, 8), 8.52(2H, d, J=6.2Hz), 8.92(1 H, s), 8.97(2H, d, J=6.2Hz), 9.52(1H, d, J=8.4Hz). 字施例 10

実施例 6と同様にして以下の化合物を製造した。

7 B-[2-(5-アミノ-1, 2, 4-チアジアゾール-3-イル)-2(1) 30 -シクロベンチルオキシイミフアセトアミド]-3-[(E)-2-(4-(1-メチルヒリジニウム-4-イル)チアジール-2-イル) チオエテニル-3-セフェム-4-カルポキシレート

1R(KBr): 1765, 1635, 1605; NNR(DMSO-d.): 1.42-2.00 (8H, m), 3.52(1H, d, J=17.6Hz). 3.62(1H, d, J=17.6H z), 4,31(3H, s), 4.70-4.77(3H; m), 5.10(1H, d, J= 4.8Hz), 5.64(1H, dd, J=4.8, 8.2Hz), 6.53(1H, d, J= 15, 2Hz), 7, 57(1H, d, 15, 2Hz), 8, 15(2H, bs), 8, 56(2 H, d, J=6.6Hz), 8.92(1H, s), 8.98(2H, d, J=6.6Hz), 9.50(1H. d. J=8.2Bz).

【0066】実施例 11

7β-[2-(5-アミノ-1,2,4+チアジアソール-3-イル)-2(Z) -イソプロポキシイミノアセトアミド]-3-[4-(1-メチル ピリジニウム-4-イル)チアゾール-2-イル]チオ-3-セフ ェム-4-カルポキシレート

7-アミノ-3-[4-(1-メチルピリジニウム-4-イル)チアゾ ール-2-イル]チオ-3-セフェム-4-カルボキシレート(81m g)の水-テトラヒドロフラン(1:2, 3ml)溶液を、重曹水 でpH 8に調整しなから2-(5-アミノ-1,2,4-チアジアゾー ル-3-イル)-2(2)-イソプロポキシイミノアチルクロリド 50 -メトキシイミノアセトアミド]-3-[4-(1-メチルピリジ

塩酸塩(86g)を少しずつ加えた。15分後テトラヒドロ フランを留去し、残留物をダイアイオンHP-20クロマト グラフィーに付し、20%および25%エタノールで溶出し、 議構、家膳乾燥し表現化合物を得た(47歳、40.5%)。 IR (KBr) : 1775, 1640, 1610, NHR (DESO-64) : 1. 23(3H. d. J=6.4Hz), 1.27(3H; d, J=6.4Hz), 3.32(1H, d. J=1

46

7, 2Hz), 3, 90(1H, d, J=17, 2Hz), 4, 32(3H, s), 4, 39(1 H, m), 5.19(1H, d, J=5.2Hz), 5.72(1H, dd, J=5.2. 8.4Hz), 8.17(2H, s), 8.46(2H, d, J=6.6Hz), 8.89(1 H. s), 8.97(2H, d, J=6.6Hz), 9.61(1H, d, J=8.4Hz).

宝箱保 12 実施例 11と同様にして以下の化合物を製造した。

78-[2-(5-アミノ-1, 2.4-チアジアゾール-3-イル)-2(2) -フルオロメドキシイミノアセトアミド]-8-[4-(1-メチ ルピリジニウム-4-イル)チアゾール-2-イル]チオ-3-セ フェム-4-カルポキシレート

IR(KBr): 1775, 1640, 1610. NMR(DMSO-ds): 3.34(1H, d, J=16.8Hz), 3.89(1H, d, J=16.8Hz), 4.30(3H, s), 5. 19(1H, d, J=5. OHz), 5. 74'1H, dd, J=5. 0, 8. 4Hz). 5. 79(2H, d, J=54.6Hz), 8. 22(2H, d, J=6.8Hz), 8. 49 (2H, d, J=6.8Hz), 8.88(1H, s), 8.96(2H, d, J=6.8H z), 9.84(1H, d, J=8.4Hz).

【0067】実施例 13

実施例 11と同様にして以下の化合物を製造した。

78-[2-(5-アミノ-1, 2, 4-チアジアゾール-3-イル)-2(2) -エトキシイミノアセトアミド]-3-[4-(1-メチルピリジ ニウム-4-イル)チアゾール-2-イル]チオ-3-セフェム-4-カルポキシレート

IR(KBr): 1775, 1640, 1615, NNR(DNSO-de): 1.25(3H, t, J=7.0Hz), 3.34(1H, d, J=17.2Hz), 3.89(1H, d, J= 17.2Hz), 4.18(2H, q, J=7.0Hz), 4.30(3H, s), 5.18(1 H, d, J=5.2Hz), 5.73(1H, dd, J=5.2, 8.4Hz), 8.13(2 H. s), 8.49(2H, d, J=6.6Hz), 8.88(1H, s), 8.95(2H, d. J=6.6Hz), 9.62(1H, d, J=8.4Hz).

宴施例 14

実施例 11と同様にして以下の化合物を製造した。

78-[2-(5-アミノ-1, 2, 4-チアジアゾール-3-イル)-2(1) -シクロペンチルオキシイミノアセトアミド]-3-[4-(1-メチルピリジニウム-4-イル)チアゾール-2-イル]チオ-3 -セフェム-4-カルポキシレート

IR(KBr): 1770, 1640, 1615, NMR(DMSO-d.): 1.42-1.98 (BH, m), 3.33(1H, d, J=17.6Hz). 3.90(1H, d, J=17.6H z), 4,30(3H, s), 4,70-4,78(1H, m), 5,18(1H, d, J= 5.2Hz), 5.70(1H, dd, J=5.2, 8.2Hz), 8.14(2H, s), 8.49(2H, d. J=6.6Hz), 8.89(1H, s), 8.95(2H, d. J= 6.6Hz), 19.75(1H, d, J=8.2Hz).

【0068】実施例 15

実施例 11と同様にして以下の化合物を製造した。 78-[2-(5-アミノ-1, 2, 4-チアジアゾール-3-イル)-2(1)

ニウム-4-イル)チアゾール-2-イル]チオ-3-セフェム-4-カルボキシレート

IR(KB): 1770, 1640, 1610, NURRICHMSO-d.): 8.53(IR. d. J=17.5Hz). 3.91(IH. d. J=17.5Hz). 3.92(3H. s). 4.31(3H. s). 5.17(IH. d. J=5.2Hz). 5.74(IH. dd. J=5.2Hz). 5.74(IH. dd. J=5.2, 8.4Hz). 8.15(2H. s). 8.47(2H. d. J=6.6Hz). 8.89(IH. s). 8.97(2H. d. J=6.6Hz). 9.66(IH. d. J=8.4Hz).

実施例 16

実施例 1と間様にして以下の化合物を製造した。

7β-[2-(5-アミノ-1, 2, 4-チアジアゾール-3-イル)-2(1) -メトキシイミノアセトアミド]-3-[(R)-2-(7-メチルチ アソロ[5, 4-b] ピリジニウム-2-イル)チオエテニル]-3-ャフェム-4-カルボキシレート

IR(KBr): 3400, 1770, 1670, 1600, NMR(DMSO-d_b): 3.5 8(1H, d, J=17.0Hr), 3.73(1H, d, J=17.0Hr), 3.93(3H, s), 4.50(3H, s), 5.13(1H, d, J=4.8Hr), 5.69(1H, d d, J=4.8, 8.4Hr), 6.66(1H, d, J=15.2Hr), 7.71(1H, d, J=15.2Hr), 8:09-8.17(4H, m), 8.91(1H, d, J=8.2Hr a), 9.04(1H, d, J=5.8Hr), 9.58(1H, d, J=8.4Hr), 10.06(9), 924(9H, d, J=8.4Hr),

事施例 11と同様にして以下の化合物を製造した。

7β-[2-(5-アミソ-1, 2, 4-チアジアゾール-3-イル)-2(Z)
-メトキシイミノアセトアミド]-3-[4-(1-(2-チアゾリル メチル) ピリジニウム-4-イル)チアゾール-2-イル]チオ-3-ヤフェム-4-カルポキシレート

IR(KBr): 1770, 1670, 1635, 1610, NHR(DMSO-da): 3.3
4(1H, d, J=16.8Hz), 3.89(1H, d, J=16.8Hz), 3.91(3H, s), 5.16(1H, d, J=5.2Hz), 5.72(1H, dd, J=5.2, 84.4Hz), 6.24(2H, s), 7.86(1H, d, J=3.2Hz), 7.89(2H, d, J=3.2Hz), 8.12(2H, ba), 8.58(2H, d, J=6.8Hz), 8.93(1H, s), 9.16(2H, d, J=6.8Hz), 9.63(1H, d, J=8.4Hz).

実施例 18

実施例 11と同様にして以下の化合物を製造した。

7 ß - [2-(5-アミノ-1, 2, 4-チアジアゾール-3-イル)-2(1)
- フルオロメトギシイミノアセトアミド]-3-[4-(1-(2-チ
アソリルメチル) ピリジニウム-4-イル) チアゾール-2-イ
ル]チオ-3-ヤフェム-4-カルボキシレート

IR(KBr): 1770, 1670, 1635, 1610. NMR(DMSO-de): 3. 34 (1H, d, J=17.0Hz), 3. 9 J = 1 7. 0 H z), 4.30 0 (1 H. d. (3H, s), 5.19 (1H, d, J=5. 5. 74 (1H, dd, J=5.2, 2 H z) . 8. 0 Hz), 5. 78 (2H, d. J = 56. 25 (2H, s), 7.86 5. 2 H z). (1H, d, J=3.2Hz), 7.88 (1H, J = 3. 2 H z), 8. 20 (2 H, 8, 57 (2H, d, J=6.6Hz), 8. 92 (1H, s), 9. 16 (2H, d,

48
J=6.6Hz), 9.84(1H, d, J=8.0Hz).

【0070】実施例 19

実施例 11と同様にして以下の化合物を製造した。

7ß-[2-(5-アミノ-1.2,4-チアジアゾール-3-イル)-2(2) -メトキシイミノアセトアミド]-3-(1-(5-メチルチアゾ ロ[4,5-c]ピリジニウム-2-イル)チオ-3-セフェム-4-カ ルポキシレート

1R(KBr): 1775, 1645, 1610, NNR(D₂O): 3.61(1H, d, J JO =18.4Hz), 4.07(1H, d, J=18.4Hz), 4.08(3H, s), 4.52 (3H, s), 5.44(1H, d, J=4.8Hz), -5.92(1H, d, J=4.8H z), 8.48(2H, m), 9.26(1H, s).

実施例 20 実施例 11と同様にして以下の化合物を製造した。

7 β - [2-(5-アミノ-1, 2, 4-チアジアソール-3-イル)-2(2) - フルオロメトキシイミノアセトアミド]-3-(1-(5-メチ ルチアソロ[4, 5-c] ビリジニウム-2-イル)チオ-3-セフェ ム-4-カルボキシレート

IR(KBr): 1775, 1645, 1610, NMR(DrO): 3.63(1H, d, J 20 = 16.8Hz), 4.09(1H, d, J=15.8Hz), 4.47(3H, s), 5.47 (1H, d, J=4.6Hz), 5.87(1H, d, J=53.8Hz), 5.87(1H, d, J=4.6Hz), 8.49(2H, a), 9.27(1H, s),

実施例 11と同様にして以下の化合物を製造した。

【0071】実施例 21

7β-[2-(5-アミノ-1, 2, 4-チアジアゾール-3-イル)-2(2) -メトキシイミノアセトアミド]-3-(4-(1-メチルビリジ ニウム-3-イル)チアゾール-2-イル]チオ-3-セフェム-4-カルボキシレート

R(KBr): 1770, 1665, 1610, NUR(ONSO-da): 3.31(1H, 30 d, J=16.4Hz), 3.87(1H, d, J=16.4Hz), 3.92(3H, s), 4.42(3H, s), 5.16(1H, d, J=5.2Hz), 5.72(1H, dd, J=5.2, 8.6Hz), 8.12-8.18(3H, m), 8.52(1H, s), 8.92(1H, d, J=6.2Hz), 8.97(1H, d, J=9.2Hz), 9.52(1H, s), 9.64(1H, d, J=6.8Hz), 2.64(1H, d, J=6.8Hz), 3.84(1H, d, J=6.8Hz), 3.85(1H, d,

実施例 22

実施例 11と同様にして以下の化合物を製造した。

7B-[2-(5-アミノ-1, 2, 4-チアジアゾール-3-イル)-2(2) - フルオロメトキシイミノアセトアミド]-3-[4-(1-メチ ルピリジニウム-3-イル)チアゾール-2-イル]チオ-3-セ フェム-4-カルポキシレート

IR(KBT): 1770, 1670, 1620, NMR/GMSO-da): 3.31(1H, d, J=16.8Hz), 3.88(1H, d, J=16.8Hz), 4.42(3H, s), 5.18(1H, d, J=5.0Hz), 5.74(1H, dd, J=5.0, 8.4Hz), 5.79(2H, d, J=55.4Hz), 8.16(1H, dd, J=5.6, 8.4Hz), 8.22(2H, s), 8.51(1H, s), 8.92(1H, d, J=5.6Hz), 8.98(1H, d, J=8.4Hz), 9.52(1H, s), 9.85(1H, d, J=8.4Hz), 9.84(1H, d, J=8.4Hz)

[0072] 実施例 23

事集例 11と同様にして以下の化合物を製造した。

50 78-[2-(5-アミノ-1, 2, 4-チアジアゾール-3-イル)-2(2)

49 - メトキシイミノアセトアミド]-3-[4-(1-メチルビリジ ニウム-2-イル)チアソール-2-イル]チオ-3-セフェム-4-カルボキシレート

容施例 24

実施例 11と同様にして以下の化合物を製造した。 7β-[2-(5-アミノ-1, 2, 4-チアジアゾール-3-イル)-2(1) -フルオロメトキシイミノアセトアミド]-3-[4-(1-メチル)ピリジニウム-2-イル)チアゾール-2-イル)チオ-3-セフェム-4-カルボキシレート

IR (KBr): 1775, 1660, 1615. NOR(TMMSO-d.): 3.30 (LH. d. J=17.6Hz). 3.86 (LH. d. J=17.6Hz). 4.40 (3H. s). 5.16 (LH. d. J=5.0Hz). 5.73 (LH. d. J=5.0 8.4Hz). 8.11 (LH. m). 8.25 (2HI s). 8.34 (LH. d. J=7.8Hz). 8.63 (LH. d.). 8.11 (LH. d.) J=3.8Hz). 9.86 (LH. d.). J= 20

【0073】 宴施例 25 ·

実施例 11と同様にして以下の化合物を製造した。

78-[2-(5-アミノ-1, 3.4-チアジ東ゾール-3-イル)-\$(2)
-イソプロポキシイミノアセトアミド]-3-[4-(1-メデル ビリジニウム-8-イル)チアゾール-2-イル]チオ-3-セフ ェム-4-カルポキシレート

IR (KBr): 1770, 1660, 1610, NMR (IMSO-64): 1, 22 (3H, d, J=4, 6Hz), 1, 27 (3H, d, J=4, 6Hz), 3, 27 (1H, d, J=1, 2Hz), 3, 3, 88 (1H, d, J=17, 2Hz), 4, 37 (1H, m), 4, 40 (3, H, s), 5, 18 (4H, d, J=5, 0Hz), 5, 73 (3H, dd, J=5, 0, 9, 0Hz), 8, 11 (1H, m), 8, 17 (2H, s), 8, 54 (1H, s,), 8, 63 (3H, m), 9, 11 (1H, d, J=6, 0Hz), 9, 61 (1H, d, J=8, 6, Hz).

実施例 26

実施例 11と開機にして以下の化合物を開発した。 7β-[2-(6-アミノ-1, 2,4-チアジアゾール・8-イル)-2(2) -メトキシイミノフセトアミド]-3-[4-(1-メチルビリジ ニウム-3-イル)チオフェン-2-イル]チオ-3-セフェム-4-カルポキシレート

IR (KBr): 1770, 1660, 1610, NMR (DMS0-d.): 3.19(1H. d. J=18.6Hz), 3.41(1H. d. J=18.6Hz), 3.84(3H. s), 4.39(3H. s), 4.39(3H. s), 5.58(1H. dd. J=5.0Hz), 5.58(1H. dd. J=5.0, 9.0Hz), 7.91(1H. d. J=1.4Hz), 8.14(3H. d.), 8.44(1H. d. J=1.4Hz), 8.89(2H. d. J=6.2Hz), 9.50(1H. d. J=8.6Hz), 9.53(1H. s).

【0074】実施例 27

車施例 11と同様にして以下の化合物を製造した。

7β-[2-(5-アミノ-1, 2, 4-チアジアゾール-3-イル)-2(2) -フルオロメトキシイミノアセトアミド]-3-[4-(1-メチ 50

50 ルビリジニウム-3-イル)チオフェン-2-イル]チオ-3-セ フェム-4-カルポキシレート

IR(KBr): 1770. 1665, 1610. NMR(DMSO-de): 3. 1 d. J=17.0Hz). 3, 40 9 (1 H. 4.39(3 J = 17.0 Hz), (1H. d. I = 4.6 Hs), 5, 01 (1H, ď J = 4.6.8.05. 61 (1H, dd, 5. 75 (2H. d, J = 55.2 HHz). J = 1.4 Hz). 7. 91 (1H, d. 8. 14 (1 H. m). 8. 23 (2H. 8. 43 (1H, d. I=1.4Hz). e): J = 6.2 Hz). 8.89 (2H.d. 3 (1H, s), 9. 70 (1H, d, OHz).

車施例 28:

実施例 11と同様にして以下の化合物を製造した。

7ß-[2-(5-アミノ-1, 2,4-チアジアソール-3-イル)-2(1) -イソプロボキシイミノアセトアミド]-3-[4-(1-メデル ピリジニウム-3-イル)チオフェン-2-イル]チオ-3-セフ ェム-4-カルボキシレート

IR(KBr): 1770. 1680. 1615. NMR(DMSO-da): 1.19(3H. d., 1=3.2Hz). 1.22(3H. d., 1=3.2Hz). 3.18(1H. d., 1=17.2Hz). 3.49(1H. d., 1=17.2Hz). 4.36(1H. m). 4.39 (3H. s.), 5.01(1H. d., 1=4.8Hz). 5.61(1H. dd., 1=4.8, 8.6Hz). 7.91(1H. d., 1=1.4Hz). 8.16(3H. m). 8.44(1H. d., 1=1.4Hz). 8.9(2H. d., 1=7.0Hz). 9.52(1H. s). (0 0 7 5). 実施研 29

寒簾例 11と衝機にして以下の化合物を製造した。

78-[2-(5-7ミノ-1, 2, 4-チアジアゾール-8-イル)-2(1) -イソプロポキシイミノアセトアミド]-3-[4-(1-メチル ヒリジニウム-3-イル)チアゾール-2-イル]チオ-3-セフ ェム-4-カルポキシレート

17(NB): 1770, 1670, 1610, NMR (DMSO-d.): 1.23(3H, d.) = 6.0Hz), 1.26(3H, d.) = 6.0Hz), 3.31(1H, d.) = 16.8Hz), 3.31(1H, d.) = 16.8Hz), 3.38(1H, m), 4.42(3H, s), 1.8(1H, d.) = 5.2Hz), 5.73(1H, dd.) = 5.2, 8.6Hz), 8.13-8.20(3H, m), 8.52(1H, s), 8.92(1H, d.) = 5.8(Hz), 1.95(601H, d.) = 6.8(Hz), 8.13-8.20(3H, d.) = 8.2Hz), 9.52(1H, s), 9.60(1H, d.) = 8.6Hz), 8.96(1H, d.) = 8.9Hz), 9.52(1H, s), 9.60(1H, d.) = 8.6Hz), 9.60(1H, d.) = 8.6Hz), 9.52(1H, s), 9.60(1H, d.) = 8.6Hz), 9.52(1H, s), 9.60(1H, d.) = 8.6Hz), 9.6Hz), 9.60(1H, d.) = 8.6Hz), 9.

実施例 30

実施例 11と阿様にして以下の化合物を製造した。

78-[2-(5-アミノ-1,2,4-チアジアゾール-3-イル)-2(1) -エトキシイミノアセトアミド]-3-[4-(1-メチルビリジ ニウム-3-イル)チアゾール-2-イル]チオ-3-セフェム-4-カルボキシレート

IR(KBr): 1770, 1670, 1615, NMR(DMSO-d₀): 1.25(3H. t,]=7.0Hz), 3.31(1H, d,]=17.2Hz), 3.87(1H, d,]=17.2Hz), 4.18(2H, q,]=7.0Hz), 4.42(3H, s), 5.17(1H, d,]=5.0Hz), 5.73(1H, dd,]=5.0, 8.4Hz), 8.12=8.19(3H, m), 8.51(1H, s), 8.91(1H, d,]=6.2Hz), 8.

97(1H, d, J=8.6Hz), 9.51(1H, s), 9.63(1H, d, J=8.4 Hz).

【0076】実施例 31

客施例 11と同様にして以下の化合物を製造した。

7.8-[2-(5-アミノ-1, 2, 4-チアジアゾール-3-イル)-2(I) -メトキシイミノアセトアミド]-3-(5-メチルチエノ[3, 2 -c] ビリジニウム-2-イル)チオ-3-セフェム-4-カルボキ ->レート

IR(KBr): 1770, 1665, 1610, NMR(DMSO-d.): 3.23(1H.d., J=17.0Hz), 3.70(1H.d., J=17.0Hz), 3.89(3H.s), 4.48(3H.s), 5.10(1H.d., J=5.2Hz), 5.68(1H.dd., J=5.2, 8.2Hz), 7.82(1H.s), 8.14(2H.bs), 8.63(2H.s), 9.42(1H.s), 9.60(1H.d., J=6.2Hz).

宴旅例 32

実施例 11と同様にして以下の化合物を製造した。

78-[2-(5-アミノ-1, 2, 4-チアジアゾール-3-イル)-2(2)
-フルオロメトキシイミノアセトアミド]-3-(5-メデルチエノ[3, 2-c]ビリジニウム-2-イル)チオ-3-セフェム-4カルゼキシレート

IR(KBr): 1770, 1670, 1610, MAR(DMSO-ds): 3.22(1H, d, J=16.6Hz), 3.71(1H, d, J=16.6Hz), 4.38(3H, s), 5.13(1H, d, J=5.0Hz), 7068(1H, dd, J=5.0,8.2Hz), 5.77(2H, d, J=55.2Hz), 7.82(2H, s), 8.23(2H, bs), 8.63(2H, s), 9.43(2H, s), 9.80(1H, d, J=8.2Hz).

[0077] 家施例 33

実施例 1と同様にして以下の化合物を製造した。

7B-[2-(5-アミノ-1, 2, 4・チアジアゾール-3-イル)-2(1) -フルオロメトキジイミノアセトアミド]-3-[(町)-2・(5-メチルチエノ[3, 2-c] ビリジニウム・2-イル)チオエテニ ル]-3-セフェム-4-カルポキシレート

IR(XB): 1760, 1670, 1690, NNRCMASO-da): 3.49(IR, d, J=17.28x), 3.63(IR, d, J=17.28d), 4.83(3R, s). 5.10(IR, d, J=5.28x), 5.65(JR, dd, J=5.2.8.48x), 5.80(2R, d, J=5.5.08x), 6.51(IR, d, J=15.28x), 7.50(IR, d, J=15.28x), 7.50(IR, d, J=15.28x), 7.50(IR, d, J=18.28x), 7.50(IR, d, J=18.48x), 7.50(IR, d, J=3.84x), 7.50(IR, d, J=3.84x),

宴旅例 34

実施例 1と同様にして以下の化命物を製造した。

78-[2-(5-アミノ-1,2,4-チアジアゾール-3-イル)-2(2) -フルオロメトキシイミノアセトアミド]-3-[(6)-2-(7-メチルチアゾロ[5,4-6]ピリジニウム-2-イル)チオエテ ニル]-3-セフェム¹4-カルボギシレート

IR(KBr): 1760, 1670, 1600, NMR(DMSO-di): 3.57 (JH. d. J=16.0Hz). 3.70 (JH. d. J=16.0Hz). 4.51 (SHR s). 5.15 (JH. d. J=4.8Hz). 5.69 (JH. dd. J=4.8, 8.0 Rz). 5.81 (ZH. d. J=5.8 Hz). 6.62 (JH. d. J=4.8Hz). 7.73 (JH. d. J=14.8Hz). 8.12 (JH. dd. J=6.0, 8.4Hz). 8.2 (42H. s). 8.92 (JH. d. J=8.4Hz). 9.04 (JH. d. J=6.0Hz). 9.78 (JH. d. J=6.0Hz). 9.78 (JH. d. J=6.0Hz). 9.78 (JH. d. J=6.0Hz).

【0078】実施例 35

実施例 11と同様にして以下の化合物を製造した。

78-12-(5-アミノ-1,2.4-チアジアゾール-3-イル)-2(1)
-イソプロポキシイミノアセトアミド)-3-(5-メテルチエノ[3,2-c]とリジニウム-2-イル)チオ-3-セフェム-4-カルポキシレート

52

 $IR(KBF): 1770, 1665, 1610, NMR(DMSO-d_s): 1.21(3H, d, j=6.2E_2), 1.23(3H, d, j=6.2E_2), 3.23(1H, d, j=1.6E_2), 3.70(1H, d, j=1.8H_2), 4.30-41.44(1H, m), 4.36(3H, s), 5.12(1H, d, j=4.8H_2), 5.71(1H, dd, j=1.8H_2), 5.71(1H$

10 4.8, 8.4Hz), 7.84(1H, s), 8.16(2H, bs), 8.64(2H, s), 9.42(1H, s), 9.55(1H, d, I=8.4Hz),

実施例 36 実施例 11と間様にして以下の化合物を製造した。

7β-[2-(5-アミノ-1, 2, 4-チアジアソール-3-イル)-2(2) -フルオロメトキシイミノアセトアミド]-3-(6-メチルチ エノ[2, 3-c] ピリジニウム-2-イル) ヂオ-3-セフェム-4-カルポキシレート

IR(KBr): 1770, 1670, 1615, NMR(DM\$0-ds): 3.29(1H, d, J=17.0Hz), 3.83(1H, d, J=17.0Hz); 4.31(3H, s),

7 5.19(1H, d, J=5.0Hz), 5.74(1H, dd, J=5.0,8.4Hz), 5.79(2H, d, J=54.6Hz), 7.64(1H, s), 8.14(1H, d, J=6.6Hz), 8.22(2H, bs), 8.58(1H, d, J=6.6Hz), 9.51(1H, s), 9.85(1H, d, J=6.4Hz), 9.51(1H, s), 9.85(1H, d, J=8.4Hz), 9.85(1Hz), 9.85(1Hz), 9.85(1Hz), 9.85(1Hz), 9.85(

【0079】実施例 37

実施例 1と同様にして以下の化合物を製造した。

78-[2-(5-アミノ-1, 2, 4-チアジアゾール-3-イル)-2(2) -イソプロポキシイミノアセトアミド]-3-[(E)-2-(5-メ チルチアソロ[3, 2-c] ビリジニウム-2-イル)チオエテニ ル]-3-セフェム-4-カルポキシレート

30 IR(KBr): 1760, 1670, 1600, NNR (DMRSO-da): 1.26(3R, d, J=6,2Ra), 1.28(3R, d, J=6,2Ra), 3.48(1R, d, J=1,6,8Rr), 3.64(1R, d, J=1,16,8Rr), 4.3-64,46(1R, m), 4.39(3R, s), 5.09(1H, d, J=4,8Rz), 5.65(1H, dd, J=4,8,8,4Rz), 6.52(1H, d, J=15,2Rz), 7.49(1R, d, J=15,2Rz), 7.81(1H, s), 8.18(2R, bs), 8.64(2H, s), 9.41(1E, s), 9.52(1H, d, J=8,4Rz), 6.64(2H, s),

実施例 38

実施例 11と同様にして以下の化合物を製造した。

7β-[2-(5-アミノ-1, 2, 4-チアジアゾール-3-イル)-2(1) 40・-イソブロボキシイミノアセトアミド]-3-(6-メチルチエ ノ[2, 3-c] ピリジニウム-2-イル)チオ-3-セフェム-4-カ ルボキシレート

IR(KBr):1770, 1660, 1615, NMR(DM\$0-d+):1.23(3H, d, J=6.2Hz), 1.25(3H, d, J=6.2Hz), 3.30(1H, d, J=6.8Hz), 3.80(1H, d, J=16.8Hz), 3.80(1H, d, J=16.8Hz), 4.32(3H, s), 4.32-4.45(1H, m), 5.19(1H, d, J=5.0Hz), 5.75(1H, dd, J=5.0, B, 4Hz), 7.63(1H, s), 8.12(1H, d, J=6.68z), 8.12(1H, d, J=6.8Hz), 9.61(1H, d, J=8.4Hz), 9.61(1H, d, J=8.4H

50 [0080] 実施例 39

実施例 40

実施例 1と間様にして以下の化合物を製造した。

7月-[2-(5-アミノ-1, 2, 4+チアジアソール-8-イル)-2(1) -エトキシイミノアセトアミド]-3-[(B)-2-(5-メチルチ アソロ(3,2-c)|ピリジニウム-2-イル)・チオエテニル]-3-セフェム-4-カルボキシレート

IR (KBr): 1760, 1675, 1600, NMR (DMSO-64): 1.2778H.

1, J=7, ORE), 3.49(1H. d., J=17, ORE), 3.61(1H, d., J=
17, OHE), 4:18(2M, q., J=7, OHE), 4:18(2M, q., J=7, OH
2), 4:38(3M, s), 5, D8(1H, d., J=4, SHE), 5.65(1H, d., J=4, SHE), 5.65(1H, d., J=15, AHE), 7.49(1H, d., J=15, AHE), 7.781(1H, g.), 8.16(2H, bg), 8.64(2H, s), 9.40(1H, s), 9.54(1H, d., J=8, SHE), 1.

[0081] 実施例 41

実施例 11と同様にして以下の化合物を製造した。

7B-[2-(5-アミノ-1,2,4-チアジアゾール-3-イル)-2(2) -フルオロメトキシイミノアセトアミド3-3-[5-メチル-4 -(1-メチルビリジニウム-9-イル)チアゾール-2-イル]チ オ-3-セフェム-4-カルボモジレート

18(KBr) 1770, 1690, 1840, 1810, NMR(UNSO-d₁) ;2.7 30 1(3H, s), 3.41(1H, d, J=16.8Hz), 3.85(1H, d, J=16.8Hz), 4.38(3H, s), 5.19(1H, d, J=5.2Hz), 5.73(1H, d, J=5.2, 8.2Hz), 5.79(2H, d, J=55.2Hz), 8.23(2H, s), 8.32(2H, d, J=6.8Hz), 8.94(2H, d, J=6.8Hz), 9.

寒簾例 42

実施例 11と同様にして以下の化合物を製造した。

7β-[2-(6-アミノ-1,-2,4+アジアゾール+3-イル)-2(1)
-エトキシイミノアセトアミド]-3-[5-メチル・4-(1-メチルビリジニウム-4-イル)チアゾール-2-イル]チャ-3-セフ 40
エム-4-カルポキシレート

[0082] 実施例 43

実施例 11と同様にして以下の化合物を製造した。 7ß-[2-(5-アミノ-1,2,4-チアジアゾール-3-イル)-2(2) 50

54 -イソプロポキシイミノアセトフミド]-3-[5-メチル-4-(1-メチルビリジニウム-4-イル)チアソール-2-イル]チ オ-3-セフェム-4-カルポキシレート

IR(KBF): 1770, 1670, 1640, 1610, NMR(DMSO-d₄): 1.2 5(6H, m), 2.74(3H, s), 3.43(1H, d, J=16.6Hz), 3.85 (1H, d, J=16.6Hz), 4.39(1H, m), 5.16(1H, d, J=5.2H m), 5.72(1H, dd, J=5.2, 9.2Hz), 8.15(2H, s), 8.33(2 H, d, J=7.2Hz), 8.95(2H, d, J=7.2Hz), 9.58(1H, d, J=9.2Hz).

10 実施例 44

実施例 11と同様にして以下の化合物を製造した。

78-[2-(6-アミノ-1, 2, 4-チアジアゾール-3-イル)-2(1) - フルオロメトキシイミノアセトアミド]-3-[5-メチル-4 -(1-カルパモイルメチルビリジニウム-4-イル)チアゾー ル-2-イル]チオ-3-セフェム-4-カルポキシレート IK(BF): 1:770, 1690, 1840, 1610, MRK(MSO-64): 3.5 3(18, d.]=16.88t), 3.91(18, d.]=16.88t), 5.21(18.

17(187): 17(7), 1990, 1900, 1910, 19

【0083】実施例 45

実施例 11と開係にして以下の化合物を製造した。

78-[2-(5-アミノ-1.2.4-デアジアゾールー3-イル)-2(2) -エトキシイミノアセトアミド]-3-[5-メチル-4-(1-カル パモイルメテルビリジニウム-4-イル)チアゾール-2-イ ル]チオ-3-セフェム-4-カルポキシレート

IR(KBP): 1770, 1690, 1640, MBR(MBS)-da): 1.25(3H.
1. 1=7.4HP), 3.40(1H. d. J=17.2HP), 3.90(1H. d. J=17.2HP), 4.17(2H, q. 1=7.4HP), 5.19(1H. d. J=5.2P), 5.36(2H. s.), 5.47(1H. dd. J=5.2, 8.8HP), 7.70(1H. s.), 8.15(3H. bs), 8.48(2H. d. J=7.0HP), 8.91(2H. s.), 8.92(2H. d. J=7.0HP), 8.91(2H. s.), 8.92(2H. d. J=7.0HP), 8.91(2H. s.), 8.92(2H. d. J=7.0HP), 8.93(1H. d. J=8.8HP).

実施例 46

宴旅例 11と同様にして以下の化合物を製造した。

7β-[2-(5-アミノ-1, 2, 4-チアジアゾール-3-イル)-2(1) -フルオロメトキシイミノアセトアミド]-3-(4-(1-メチ ルピリジニウム-4-イル)チオフェン-2-イル]チオ-3-セ フェム-4-カルポキシレート

IR(KBr): 1760, 1670, 1635, 1605, NOR(DMSO-d.): 3.
19(1H. d., J=16.8Hz).3.54(1H. d., J=16.8Hz).4.29(3 H. s). 5.02(1H. d., J=4.8Hz). 5.562(1H. d., J=4.8Hz). 5.76(2H. d., J=5.5 8Hz). 8.04(1H. d., J=1.2Hz). 8.25(2H. bs). 8.43(2H. d., J=6.6Hz). 8.78(1H. d., J=1.2Hz). 8.95(2H. d., J=6.6Hz). 9.74(1H. d., J=1.2Hz). 8.95(2H. d., J=6.6Hz). 9.74(1H. d., J=8.4Hz).

実施例の化合物の構造式は次の通り。

100841

[表1]

(C) 2000 Copyright Derwent Information Ltd.

R ²	n	L
CH₃	1	S CI,
CH _S F	1	S S CHs
C2H6	1	у СН,
CH(CH ₈) ₂	1	S CH.
· -	1	у тень
Ne	1	S S S
CH _s F	1	-S-S-CH*
C ₂ H ₅	1	й-сн.
	CH ₀ F CaH ₆ CH(CH ₀) ₂ We CH ₂ F	CH ₀ 1 CH ₀ F 1 CH(CH ₀) ₂ 1

[0085]

実施例 No.	R²	n	L
9	CH(CH ₃) ₂	1	ST-CH,
10	Q	i	STO CH,
11	CH(CH _s) ₂	0	S S S
1 2	CH.F	0	S CH.
1 3	C ₂ H ₅	0	N-CH,
1 4	0	0	N -CH,
15	CH ₃	0	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
1 6	CH ₂	1	S S CH ₃
	ŀ	I	I

[0086]

[表3]

実施例 No.	R²	n	L
17	CE.	0	
18	CH _s F	0	· s D C C C C C C C C C C C C C C C C C C
19	CH ₃	o	S'S CH;
20	CH ₂ F	0	S S CH,
21	CH ₃	0	S - CUs
2 2	CH ₂ F	0	N-CB,
2 3	CH,	,0	STS CH,
2 4	CH ₂ F	0	ST CE,
	I	ł	

[0087]

$$\begin{array}{c|c} & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & &$$

実施例	No.	R 2	n	L
2	5	CH(CH _s);	0	STE CH,
2	6	CH ₃	0	N-CH,
2	7	CH₂F	0	N-CH,
2	8	CB(CH ₃);	0	ST-CH,
2	9	CH(CH ₃) ₂	0	S S S CH.
3	0	C ₂ H ₈	0	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
3	1	CH ₅	0	STST CB.
3	2	CH ₂ F.	0	SIST CH,
		1	1	[表5]

[0088]

実施例 No.	R²	n	L Same
3 3	CH ₂ F	1	у торгон,
3 4	Ck₂F	1	S S CH.
3 5	CH(CH ₈) ₂	1	S S CH3
3 6	ÇH₂F	0	STST-CH ₃
3 7	CR(CH ₃) ₂	1	ST CH.
3 8	CH(CH ₀):	0	STST CH.
3 9	С2Н5	0	of cHs
40	C₂H₅	1	ST ST CHS
1			【表 6 】

[0089]

$$\begin{array}{c} 65 \\ \text{NB}_2 \\ \text{OR}^2 \\ \text{COO}_{\text{COO}} \\ \end{array}$$

実施例 No.	R 2	n	L
4 1	CH₂F	0	**************************************
4 2	C ₂ H ₅	0	S CH,
4 3	CH(CH ₈) ₂	0	S CIIs
4 4	CH eF	0	CONH ₂
4 5	Сай	0	CONE:
4 6	CH₃F	0	S C S - 10

[0090]試験例1

試験化合物最小阻止歯底 (MIC: minimal inhibitory concentration) は海天希奈法 (agar dilution actho d) により決定された。即ち、順太卿められた試験化合物の水溶液は、1.0mlをシャーレ (petni dish) に注ぎ、次にトリプティカーゼ ソイ アガー (Trypticase soy 40 agar) 9.0mlを注いで混ぜた。その程合東天ブレート上に、試験間の懸濁液 (約10°CFU/ml) を整体した。3.7℃で一夜培養 (incubation) した後、試験値の増加を完全に阻害する試験化合物の最低濃度をMICとした。

試験菌

(1)スタフィロコッカス アウレウス N133 (MR SA)

(Siaphylococcus aureus N133) (MRSA) (2)スタフィロコッカス アウレウス OFU4 (MR

(Staphylococcus aureus OFU4) (MRSA) 結果:

【0091】 【表7】

	MIC ug/ml				
実施例 No.	試験者(1)	試験 第(2)			
2	1.56	1.56			
3	1.56	1.56			
4	1.56	3.13			
5	0.78	1.56			
10	1.56	1.56			
11	1.56	1.56			
12	1.56	3.13			
13	1.56	3.13			
14	1.56	1.56			
18	1.56	1.56			
2 1	3.13	1.56			
22	1.56	1.56			
25	3.13	1.56			
28	3.13	1.56			
29	1.56	1.56			
30	1.56	1.56			
3 2	1.56	1.56			
3.3	1.56	1.56			
3 5	0.78	0.78			
38	1.56	1.56			
3 9	1.56	1.56			
40	1.56	1.56			
4 1	1.56	1.56			
4 2	1.56	1.56			
4 3	1.56	1.56			
4 4	1.56	1.56			
4.5	1.56	1.56			

この結果より、本発明のセフェム化合物 (1) またはそ の塩もしくはエステルは、臨床上直要残されている病原 性細菌とくにMRSAに対して、優れた抗菌作用を示す ことが明らかである。

[0092]

「発明の効果」本発明のセフェム化合物 (I) またはそ

のエステルあるいはその塩は、シュードモナス属の菌を 含むグラム陰性菌ならびにブドウ球菌およびMRSAを 含むグラム陽性菌などに対して成画の抗菌スペトル と優れた抗菌作用を有しており、これらの菌に基づく感 染底に対し有効な抗菌体是後することができる。